

## Mitteilungsblatt der Universität Kassel

---

### Inhalt

	Seite
1. Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Kunstwissenschaft der Kunsthochschule Kassel der Universität Kassel	1115
2. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang English and American Culture and Business Studies/Anglistik, Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Kassel	1136
3. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang English and American Culture and Business Studies/Anglistik und Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Kassel	1138
4. Fachprüfungsordnung für den Masterstudiengang Optical Nano Technologies Engineering (ONTE) des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik der Universität Kassel	1139

#### Impressum

Verlag und Herausgeber:

Universität Kassel, Mönchebergstrasse 19, 34125 Kassel

Redaktion (verantwortlich):

Personalabteilung – Personalentwicklung, Weiterbildung, Organisation und Innerer Dienst

Dorothea Gobrecht

E-Mail: [gobrecht@uni-kassel.de](mailto:gobrecht@uni-kassel.de)

[www.uni-kassel.de/mitteilungsblatt](http://www.uni-kassel.de/mitteilungsblatt)

Erscheinungsweise: unregelmäßig

**Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Kunstwissenschaft der Kunsthochschule Kassel der  
Universität Kassel vom 05. September 2011**

Inhalt

I. Allgemeines

- § 1 Geltungsbereich
- § 2 Akademischer Grad
- § 3 Regelstudienzeit, Umfang des Studiums, Studienbeginn
- § 4 Prüfungsausschuss

II. Bachelorabschluss

- § 5 Besondere Zulassungsvoraussetzungen zum Bachelorstudium
- § 6 Prüfungsteile des Bachelorabschlusses
- § 7 Praxismodul
- § 8 Bachelorarbeit und Kolloquium
- § 9 Bildung und Gewichtung der Note

III. Kunstwissenschaft als Nebenfach in Bachelorstudiengängen anderer Fachbereiche

- § 10 Studienbeginn im Bachelor-Nebenfach
- § 11 Modulprüfungen im Bachelor-Nebenfach
- § 12 Bildung und Gewichtung der Note

IV. Schlussbestimmungen

- § 13 In-Kraft-Treten
- § 14 Außer-Kraft-Treten

Anlagen

## **I. Allgemeines**

### **§ 1 Geltungsbereich**

Die Prüfungsordnung der Kunsthochschule Kassel für den Bachelorstudiengang Kunstwissenschaft enthält ergänzende Regelungen zu den Allgemeinen Bestimmungen für Fachprüfungsordnungen der Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und Master der Universität Kassel (AB Bachelor/Master) in der jeweils geltenden Fassung.

### **§ 2 Akademischer Grad**

Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ (B.A.) durch die Kunsthochschule Kassel verliehen.

### **§ 3 Regelstudienzeit, Umfang des Studiums, Studienbeginn**

(1) Die Regelstudienzeit für das Bachelorstudium beträgt sechs Semester einschließlich eines fachbezogenen Praktikums bzw. Werkstattprojektes im Umfang von insgesamt ca. 2 Monaten und der Bachelorarbeit einschließlich Kolloquium.

(2) Im Bachelorstudium müssen 180 Credits erlangt werden, davon 40 Credits für das Nebenfach gem. Anlage 1, 11 Credits für das fachbezogene Praktikum und 12 Credits für die Bachelorarbeit inklusive Bachelorkolloquium.

(3) Das Bachelor-Studium beginnt jeweils zum Wintersemester.

### **§ 4 Prüfungsausschuss**

(1) Entscheidungen in Prüfungsangelegenheiten trifft der Prüfungsausschuss Kunstwissenschaft.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:

- a) drei Professorinnen oder Professoren,
- b) eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter,
- c) eine Studierende oder ein Studierender des Bachelor-/Masterstudiengangs Kunstwissenschaft.

## **II. Bachelorabschluss**

### **§ 5 Besondere Zulassungsvoraussetzungen zum Bachelorstudium**

(1) Voraussetzung zur Zulassung zum Bachelorstudium Kunstwissenschaft ist der Nachweis von Kenntnissen des Englischen auf dem Niveau B 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Fremdsprachen (GER).

(2) Bis zur Anmeldung zur Bachelorarbeit muss eine zweite moderne Fremdsprache, empfohlen werden insbesondere Italienisch, Französisch, Niederländisch oder Spanisch, auf dem Niveau B 1 GER nachgewiesen werden.

## § 6 Prüfungsteile des Bachelorabschlusses

(1) Der Bachelorabschluss besteht aus den Modulprüfungen der in Absatz 1 a aufgeführten Module und der Bachelorarbeit einschließlich Kolloquium gem. § 8:

a) Hauptfach Kunstwissenschaft

Modul I Analyse und Interpretation von Kunstwerken 14 c

Modul II Klassische Kunstgeschichte 19 c

Modul III Ikonographie – Ikonologie – Bildwissenschaften 15 c

Modul IV Grundlagen der modernen Kunst (Geschichte und Konzepte) 13 c

Modul V Theorie und Geschichte der Kunstwissenschaft 18 c

Modul VI Kunstwissenschaftliche Probleme der künstlerischen Praxis 11 c

Modul VII Kultur/Sprache Kommunikation 11 c

Modul VIII Wissenschaft, Kunst und Kunstbetrieb 15 c

Modul IX Additive Schlüsselkompetenzen 12 c

Bachelormodul:

Modul X Bachelormodul 12 c

b) Ein gewähltes Nebenfach gemäß Anlage 140 c

(2) Als Prüfungsleistungen kommen in Frage:

- Klausur (90 bis 240 Minuten),
- Mündliche Prüfung (20 bis 30 Minuten),
- Schriftliche Hausarbeit (15 Seiten),
- Referat (Vortrag auf der Basis schriftlicher Ausarbeitungen),

(3) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn alle Modulteilprüfungsleistungen mit mindestens ausreichend (4,0) bewertet sind.

## § 7 Praktikum/Tutorium

(1) Im Rahmen des Bachelorstudiengangs ist ein 2-monatiges Praktikum oder ein Werkstattprojekt oder die Leitung eines Tutoriums an der Kunsthochschule Kassel zu absolvieren. Für das Praktikum, das Werkstattprojekt oder die Leitung eines Tutoriums werden jeweils 12 Credits (360h) vergeben.

(2) Das Praktikum ist in der Regel ohne Unterbrechung in der lehrveranstaltungsfreien Zeit und das Werkstattprojekt bzw. die Leitung eines Tutoriums in der Regel innerhalb des Semesters zu absolvieren. Das Tutorium ist einer Lehrveranstaltung zugeordnet.

(3) Das Praktikum bzw. das Werkstattprojekt ist durch eine unbenotete Bescheinigung der jeweiligen Praktikumseinrichtung nachzuweisen. Der Nachweis ist durch einen schriftlichen Praktikumsbericht der Studierenden zu ergänzen. Der Praktikumsbericht ist zu benoten.

(4) Das Nähere regeln die Allgemeinen Bestimmungen für Praxismodule in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Universität Kassel in der jeweils geltenden Fassung.

### § 8 Bachelormodul

(1) Das Thema der Bachelorarbeit wird in der Regel frühestens zu Beginn des sechsten Semesters ausgegeben oder kann nach Erreichen von 120 Credits ausgegeben werden. Ausgabe des Themas und die Bestellung des Gutachters oder der Gutachterin, der bzw. die die Arbeit betreuen soll, erfolgt durch den Prüfungsausschuss auf Vorschlag des/der Studierenden.

(2) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt sechs Wochen und beginnt mit dem Tag der Bekanntgabe des Themas. Das Thema der Bachelorarbeit darf nur einmal und nur innerhalb von einer Woche zurückgegeben werden. Die Bachelorarbeit soll ca. 30 Seiten umfassen.

(3) Für die Bachelorarbeit werden 8 Credits und das Bachelorkolloquium 4 Credits vergeben.

(4) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden, so wird die Abgabefrist um die Zeit der Verhinderung, maximal jedoch um zwei Wochen verlängert.

(5) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in drei gebundenen schriftlichen Exemplaren beim Prüfungsausschuss abzugeben.

(6) Das Bachelorkolloquium kann stattfinden, wenn die Bachelorarbeit mit ‚bestanden‘ bewertet wurde. Es umfasst: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung, mündliche Präsentation des eigenen Abschlussthemas und an die Präsentation anschließende Disputation mit einer Gesamtdauer von ca. 30 Minuten.

### § 9 Bildung und Gewichtung der Note

(1) Bezieht sich eine Modulprüfung auf mehrere verschiedene Lehrveranstaltungen eines Moduls, so errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel der mit den zugehörigen Credits gewichteten Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. Die Modulnote lautet bei einem Wert bis einschließlich 1,5 = sehr gut: - eine hervorragende Leistung von 1,6 bis 2,5 = gut: eine Leistung, die deutlich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt. von 2,6 bis 3,5 = befriedigend: eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht von 3,6 bis 4,0 = ausreichend: eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt. über 4,0 = nicht ausreichend: eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.

(2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel der Gesamtnote der Hauptfachmodule, der Gesamtnote des Nebenfachs und der Note des Bachelormoduls. Dabei wird

die Gesamtnote der Hauptfachmodule mit 65 %

die Gesamtnote des Nebenfachs mit 20 %

die Note der Bachelormoduls mit 15 %

gewichtet.

(3) Die Abschlussnote wird nach den Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktesystemen neben dem deutschen Notensystem in einer relativen Note (ECTS-Bewertungsskala) ausgewiesen. Näheres regeln die Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und Master der Universität Kassel (AB Bachelor/Master) in der jeweils geltenden Fassung.

### III Kunstwissenschaft als Nebenfach in anderen Bachelor-Studiengängen

#### § 10 Studienbeginn im Bachelor-Nebenfach

Das Studium des Nebenfaches Kunstwissenschaft kann jeweils nur zum Wintersemester aufgenommen werden. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

#### § 11 Modulprüfungen im Bachelor-Nebenfach

(1) Studierende anderer Bachelorstudiengänge, die das Nebenfach Kunstwissenschaft gewählt haben, müssen folgende Modulprüfungen ablegen (vgl. Anlage 4):

Modul I Analyse und Interpretation von Kunstwerken	
a. Vorlesung, b1. Grundseminar oder b2. Übung, c. Hauptseminar	14 c
Modul II Klassische Kunstgeschichte	
a. Vorlesung, b1. Grundseminar oder b2. Übung, c. Hauptseminar	16 c
Modul III Ikonographie – Ikonologie – Bildwissenschaften	
b1. Grundseminar/Projektseminar oder b2. Vorlesung	6 c
Modul IV Grundlagen der modernen Kunst (Geschichte und Konzepte)	
a. Vorlesung	4 c

(2) Die Prüfungsart (Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit etc.) ist dem Modulhandbuch zu entnehmen (Anlage 4).

#### § 12 Bildung und Gewichtung der Note für das Bachelor-Nebenfach

Die Noten der Module gemäß § 11 gehen zu gleichen Teilen in die Abschlussnote des Nebenfachs ein.

### IV. Schlussbestimmungen

#### § 13 In-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Universität Kassel in Kraft.

Kassel, den 17. Januar 2012

Christian Philipp Müller  
Rektor der Kunsthochschule

**Modulhandbuch für den Bachelorstudiengang Kunstwissenschaft an der Kunsthochschule Kassel in der  
Universität Kassel KHR 146  
Überarbeitung B.A. 2.0 / Stand: 10.1.2011**

<p><b>Modul I</b></p>	<p><b><u>Analyse und Interpretation von Kunstwerken</u></b></p> <p>Pflichtmodul  Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Martina Sitt  Lehrende des Moduls: Sitt, Hemken, N.N., Mittelbau, Lehrbeauftragte</p>
<p>Veranstaltungen</p>	<p>Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor:</p> <p>a. Vorlesung  b1. Grundseminar <b>oder</b>  b2. Übung  c. Hauptseminar (frühestens ab dem 4. Semester)</p>
<p>Kompetenzen</p>	<p>Das Modul I hat die gesamte Geschichte der Kunst zum Gegenstand. Mittelalter, frühe und mittlere Neuzeit, Aufklärung und schließlich die Moderne sind als jene Zeitspannen zu nennen, deren künstlerische Leistungen in allen Gattungen (Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur, Kunstgewerbe sowie jüngere Ausdrucksmedien wie die Fotografie, der Film, die digitale Technik, das Happening und die Installation) Beachtung finden.</p> <p>Die Analyse und Interpretation von Kunstwerken stützt sich auf ein Methodenrepertoire, das sich im Laufe einer ca. 150jährigen Wissenschaftsgeschichte des Faches herausgebildet hat. Grundlegend werden formalästhetische, gattungsabhängige Analyseschritte (Perspektivdarstellung, Kompositionsmuster, Farbkontraste, Figur/Grund-Modus, Baubeschreibungen etc.) erlernt sowie die entsprechende wissenschaftliche Terminologie. Diese werden in den einführenden bzw. Grundseminaren und Übungen angesprochen.</p> <p>Weitergehend sind im Hauptseminar auch Deutungen aus dem Blickwinkel u.a. der Stilkritik, Motivtradition, Ikonographie/Ikonologie, Hermeneutik oder Rezeptionsästhetik entscheidend, die historisch-kritische Entstehungskontexte sowie Funktionskontexte einbeziehen. Überdies sind relevante literarische Zeugnisse wie Künstlerschriften, Vertragswerke oder Zunftregeln sowie literarische Quellen, die eine Impulsfunktion für das Kunstwerk besitzen, zu berücksichtigen.</p> <p>Ebenfalls werden hier der Einfluss des Kunstbetriebs, der Akademien und Museen als geschmacksbildende und Norm gebende Institutionen sowie programmatische Künstlerschriften (Manifeste, Künstlerpublikationen, Korrespondenzen etc.) als bedeutsame Quellen berücksichtigt.</p> <p><b>Schlüsselkompetenzen:</b> Das Modul sieht eine Vermittlung und Einübung der o. g. Analyse- und Interpretationsschritte an verschiedenen Gegenständen der Kunstgeschichte vor, wobei auf eine Unterschiedlichkeit der Gattungen, Epochen und Kontexte geachtet wird. Das Ziel ist die Aneignung eines fundamentalen Rüstzeugs für die kunstwissenschaftlich-kunstgeschichtliche Analyse und Interpretation von Kunstwerken. Die fachwissenschaftlichen Gehalte werden durch die Vorlesung und das Grundseminar/die Übung vermittelt, die Schlüsselkompetenzen durch weitere (anwendungsorientierte) Praxisveranstaltungen (Online-Recherche, computergestützte Präsentationen, Prometheus-Transfer)</p> <p>Schlüsselkompetenzen (20%):  Integrative Schlüsselkompetenzen (ISK): Textanalyse (Primär- und Sekundärquellen),</p>

	Objekt- und Prozessanalyse (bildende und angewandte Kunst, Architektur), Methodenanwendung, wissenschaftliche Recherche, interdisziplinäres Arbeiten Additive Schlüsselkompetenzen (ASK): EDV-Kenntnisse
Verwendbarkeit des Moduls	B.A.-Studium Kunstwissenschaft Im Rahmen der Bezugswissenschaften (Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaft, Theologie, Lehramt (Kunstpädagogik) können Veranstaltungen nach Absprache mit den Modulverantwortlichen auch in anderen Fachbereichen belegt werden.
Dauer und Frequenz des Moduls	Das Modul wird regelmäßig angeboten.
Sprache	Deutsch
Voraussetzungen für die Teilnahme	Immatrikulation in einem einschlägigen Studiengang der Uni Kassel
Lehr- und Lernformen	a. Vorlesung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung b1.Grundseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung, Übernahme eines Kurzreferates <b>oder</b> b2.Übung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Übernahme eines Referates c. Hauptseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung, Übernahme eines Referates, Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit
Studentischer Arbeitsaufwand	a. Vorlesung: 30h Präsenzzeit + 90h Eigenstudium / 2 SWS: 4c b1.Grundseminar: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30h Tutorium mit Kurzreferat / 2 SWS: 4c <b>oder</b> b2.Übung: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30h Referat oder AG / 2 SWS: 4c c. Hauptseminar: 30h Präsenzzeit + 90h Selbststudium + 60h Hausarbeit 2 SWS: 6c
Arbeitsaufwand des gesamten Moduls	420h
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	14c (davon 2c für SK)
1. Modul-Prüfungsleistungen	1. Hausarbeit (Hauptseminar)
2. Studienleistungen	2.Kurzreferat (Tutorium)  Die Modulnote ist die Modulprüfungsleistung.

<b>Modul II</b>	<p><b><u>Klassische Kunstgeschichte</u></b></p> <p>Pflichtmodul  Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Martina Sitt  Lehrende des Moduls: Sitt, Hemken, N.N., Mittelbau, Lehrbeauftragte</p>
Veranstaltungen	<p>Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor:</p> <p>a. Vorlesung  b1. Grundseminar <b>oder</b>  b2. Übung  c. Hauptseminar ab dem 3. Semester  d. Exkursion</p>
Kompetenzen	<p>Die Klassische Kunstgeschichte stellt einen Sammelbegriff für alle Werke der Kunst- und Architekturentwicklung des Mittelalters, der Neuzeit und der Aufklärung dar und wird landläufig mit den Stilbezeichnungen wie Romanik, Gotik, Renaissance, Barock usw. verbunden. Es handelt sich um Epochen, in denen sich wesentliche Gattungen der Kunstproduktion und bis heute wirksame Vorstellungen von Kunstwerk und Künstler herausgebildet haben. Zugleich sind diese Epochen zusammen mit der Antike und ihrem Fortleben ein wesentlicher Referenzpunkt künstlerischer Produktion geblieben, an ihnen bildeten sich grundlegende Methoden des Faches Kunstgeschichte aus. Entscheidend für den analytischen Zugriff auf die Kunst der genannten Epochen sind überdies Kenntnisse der Entstehungskontexte (Hof, Staat, Kirche, Handel etc.) und der institutionell-strukturellen Rahmenbedingungen (Kunstakademie, Werkstätten, Handel). Die Kunst der Moderne nimmt sich trotz aller Auflösungs- und Entkopplungsprozesse von dem überlieferten Regelwerk nicht aus, sondern befindet sich in der Diskussion zwischen Kontinuität und Abgrenzung zur Tradition. Einblicke in den vergangenen sowie den heutigen Umgang mit Werken der klassischen Kunstgeschichte legen bis heute die allen Fachvertretern gemeinsame Kenntnisbasis, die in den Veranstaltungen dieses Moduls gewonnen werden soll.</p> <p>Anhand regelmäßig stattfindender Übungen in den Kassler Museen wird die Beschreibung und Analyse von Kunstwerken vor Originalen eingeübt, ein Grundseminar vermittelt grundlegende Kenntnisse der Architekturgeschichte und -analyse.</p> <p>Schlüsselkompetenzen (20%):  ISK: Textanalyse (Primär- und Sekundärquellen), Objekt- und Prozessanalyse (bildende und angewandte Kunst, Architektur), Methodenanwendung, wissenschaftliche Recherche, interdisziplinäres Arbeiten  ASK: EDV-Kenntnisse</p>
Verwendbarkeit des Moduls	<p>B.A.-Studium Kunstwissenschaft</p> <p>Im Rahmen der Bezugswissenschaften (Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaft, Theologie, Lehramt (Kunstpädagogik) können Veranstaltungen nach Absprache mit den Modulverantwortlichen auch in anderen Fachbereichen belegt werden.</p>
Dauer und Frequenz des Moduls	<p>Das Modul dauert ein oder zwei Semester. Das Modul wird regelmäßig angeboten. Das Hauptseminar ist ab dem 3. Semester zu absolvieren.</p>
Sprache	<p>Deutsch</p>
Voraussetzungen für die Teilnahme	<p>Immatrikulation in einem einschlägigen Studiengang der Uni Kassel</p>

Lehr- und Lernformen	<p>a. Vorlesung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; schriftliche (Protokoll, Bericht, Klausur) oder mündliche Prüfung</p> <p>b1. Grundseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Übernahme eines Referates oder Ausarbeitung eines Portfolios oder</p> <p>b2. Übung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Übernahme eines Referates oder Ausarbeitung eines Portfolios</p> <p>c. Hauptseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Übernahme eines Referates oder Protokolls; Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit oder eines Portfolios</p> <p>d. Exkursion</p>
Studentischer Arbeitsaufwand	<p>a. Vorlesung: 30h Präsenzzeit + 90h Eigenstudium + 60h schriftliche oder mündliche Prüfung / 2 SWS: 6c</p> <p>b1. Grundseminar: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30h Kurzreferat / 2 SWS: 4c <b>oder</b></p> <p>b2. Übung: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30h Kurzreferat / 2 SWS: 4c</p> <p>c. Hauptseminar: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30h Kurzreferat oder Protokoll + 60h Hausarbeit oder Portfolio / 2 SWS: 6c</p> <p>d. Exkursion: 45 h Präsenz, 15h Selbststudium, 30h Kurzreferat: 3c</p> <p>Zum Abschluss des Moduls müssen mind. fünf Exkursionstage nachgewiesen werden. Diese können auch einzeln absolviert werden.</p>
Arbeitsaufwand des gesamten Moduls	570h / 6 SWS
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	19c (davon 2c für SK)
1. Modulprüfungsleistungen	1. mündliche oder schriftliche Modulprüfung (Vorlesung a) Hausarbeit oder Portfolio (Hauptseminar c)
2. Studienleistungen	2. Kurzreferat (Grundseminar b1 <b>oder</b> Übung b2) Kurzreferat oder Protokoll (Hauptseminar c)
Die Durchschnittsnote der beiden Modulteilprüfungen ergibt die Modulnote.	

Modul III	<p><b><u>Ikonographie – Ikonologie – Bildwissenschaften</u></b></p> <p>Pflichtmodul Grundlagen  Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Martina Sitt  Lehrende des Moduls: Sitt, Hemken, N.N., Mittelbau, Lehrbeauftragte;  Professoren aus Wahlbereichen</p>
Veranstaltungen	<p>Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor:</p> <p>a1. Grundseminar <b><u>oder</u></b>  a2. Übung</p> <p>b1. Grundseminar <b><u>oder</u></b>  b2. Vorlesung  c. Praxisveranstaltung</p>
Kompetenzen	<p>Das Modul III dient der Vermittlung von Grundlagen zur Analyse und Interpretation von Kunstwerken und konzentriert sich auf die ältere und mittlere Kunstgeschichte (Mittelalter, Frühe Neuzeit und Neuzeit). Überdies wird ein methodischer Schwerpunkt in der christlichen und profanen Ikonographie gelegt, der sich zunächst in ein Wechselspiel mit ikonologischen Aussage begibt und schließlich in Kontrast mit anderen Methoden wie die Stilanalyse oder Kontextforschung tritt.</p> <p>Die Frage nach Inhalt und Bedeutung von Werken gerade der älteren und mittleren Kunstgeschichte ist für das Studium der Kunstwissenschaft von grundlegender Bedeutung, da Inhalte christlicher, aber auch mythologischer und geschichtlicher Art nicht mehr Teil eines gemeinsamen Wissensstandes sind. So soll dieses Modul die Studierenden in die Lage versetzen, Themen sowohl der christlichen als auch der profanen Ikonographie zu erkennen und in ihrer spezifischen Behandlung zu würdigen. Darüber hinaus soll es aber auch die Fähigkeit vermitteln, das Kunstwerk in seinem historischen Kontext und hinsichtlich seiner kommunikativen Funktion zu deuten. Ebenso werden die Eigenschaften der Darstellungsweise bei der Bedeutungsanalyse beachtet. In Kenntnis und Ausübung ikonographischer Analysetechniken zeigen sich die Möglichkeiten und Bedingungen jüngerer Methoden bzw. Fragestellungen, wie sie angesichts der Kunstwerke des Mittelalters und der Neuzeit in der kunstgeschichtlichen Forschung (Iconic turn, Pictural turn, allgemeine Diskursthemen, Bildwissenschaft etc.) zentral diskutiert werden.</p> <p>Neben einer Einführung in die wesentlichen Analyseverfahren der Interpretation und Ikonographie und ggf. unter Berücksichtigung bildwissenschaftlicher Fragestellungen wird die Verwendung grundlegender Hilfsmittel eingeübt, die den Studierenden auch bei ungewöhnlichen Themen recherche- und interpretationsfähig machen. Die fachwissenschaftlichen Gehalte werden durch die Vorlesung oder das Grundseminar/die Übung vermittelt, die Schlüsselkompetenzen durch weitere (Anwendungs-orientierte) Praxisveranstaltungen (Online-Recherche, computer-gestützte Präsentationen, Prometheus-Transfer)</p> <p>Schlüsselkompetenzen (20%):  ISK: Textanalyse (Primär- und Sekundärquellen), Objekt- und Prozessanalyse (bildende und angewandte Kunst, Architektur), Methodenanwendung, wissenschaftliche Recherche, interdisziplinäres Arbeiten  ASK: EDV-Kenntnisse</p>
Verwendbarkeit des Moduls	<p>B.A.-Studium Kunstwissenschaft</p> <p>Im Rahmen der Bezugswissenschaften (Geschichtswissenschaften,</p>

	Literaturwissenschaft, Theologie, Archäologie, Lehramt (Kunstpädagogik) können Veranstaltungen nach Absprache mit den Modulverantwortlichen auch in anderen Fachbereichen belegt werden.
Dauer und Frequenz des Moduls	Das Modul wird regelmäßig angeboten.
Sprache	Deutsch
Voraussetzungen für die Teilnahme	Immatrikulation in einem einschlägigen Studiengang der Uni Kassel
Lehr- und Lernformen	a1.Grundseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Besuch eines Tutoriums <b>oder</b> a2.Übung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Mitarbeit in einer AG b1.Grundseminar/Projektseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Übernahme eines Referates oder Besuch einer AG; Anfertigung einer Hausarbeit <b>oder</b> b2.Vorlesung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; mündliche oder schriftliche Prüfung (Protokoll, Bericht, Klausur) c. Praxisveranstaltung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Rechercheaufgaben und schriftlicher Bericht
Studentischer Arbeitsaufwand	a1.Grundseminar: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30hTutorium / 2 SWS: 4c <b>oder</b> a2.Übung: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30h AG / 2 SWS: 4c b1.Grundseminar/Projektseminar: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30h AG oder Referat + 60h Hausarbeit / 2 SWS: 6c <b>oder</b> b2.Vorlesung: 30h Präsenzzeit + 90h Eigenstudium + 60h mündliche oder schriftliche Prüfung / 2 SWS 6c c. Praxisveranstaltung (computergestützte Präsentation, Bilddatenbank Prometheus, Datenbank- u. Katalogrecherche): 60h Präsenz, 60h Selbststudium, 30h Bericht, 4 SWS: 5c
Arbeitsaufwand des gesamten Moduls	450h / 6 SWS
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	15c (davon 2c für SK)
1. Modul-Prüfungsleistungen	1. Hausarbeit (Grundseminar b1) <b>oder</b> mündliche oder schriftliche Prüfung (Vorlesung b2)
2.Studienleistungen	2. Tutorium (Grundseminar a1) <b>oder</b> AG (Übung a2) Referat (Grundseminar b1) Schriftlicher Bericht (Praxisveranstaltung)
	Die Modulnote ist die Modulprüfungsleistung.

<b>Modul IV</b>	<b><u>Grundlagen der modernen Kunst (Geschichte und Konzepte)</u></b>  Pflichtmodul Modulverantwortliche: N.N. Lehrende des Moduls: Hemken, Majetschak, N.N., Mittelbau, Lehrbeauftragte
Veranstaltungen	Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor: a. Vorlesung b. Grundseminar
Kompetenzen	Die Geschichte der modernen Kunst ist von hoher Komplexität und Heterogenität der Konzepte und ästhetischen Ausdrucksformen gekennzeichnet. Neben den anspruchsvollen künstlerischen Programmatiken stellt sich als ein wichtiges Merkmal die fortgesetzte Entgrenzung der freien Kunst in andere gestalterische Gebiete wie Typographie, Produktdesign, visuelle Kommunikation oder Architektur ein. Nicht selten ist überdies eine erkenntnisorientierte Unterstützung durch andere, inhaltlich naheliegende Disziplinen, wie Psychologie, Archäologie, Philosophie, Anthropologie u.a. hilfreich.  Im Ganzen erfordert die Darlegung und Entschlüsselung von Form, Inhalt und Entstehungsimpuls der modernen Kunst sowohl methodische Souveränität als auch hohe Kompetenz in der konkreten z. T. historisierenden Analyse von Kunstwerken und Schaffensphasen einzelner Künstlerpersönlichkeiten und -gruppen im besonderen sowie Bewegungen und Tendenzen im allgemeinen. Neben der Verwendung von geläufigen Rubrizierungen (Kunst-Ismen) und zentralen Leitmodi der modernen Kunst sind überdies diachrone und synchrone Blickwinkel erforderlich sowie zeitgenössische und aktuelle Diskursthemen zu berücksichtigen. Grundlegend ist hierbei die Rekonstruktion von konzeptionellen Traditionslinien, die u. a. bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgt werden können. Schlüsselkompetenzen (20%): ISK: Textanalyse (Primär- und Sekundärquellen), Objekt- und Prozessanalyse (bildende und angewandte Kunst, Architektur), Methodenanwendung, wissenschaftliche Recherche, interdisziplinäres Arbeiten ASK: EDV-Kenntnisse, Vermittlungskompetenz
Verwendbarkeit des Moduls	B.A.-Studium Kunstwissenschaft: Pflichtbereich Im Rahmen der Bezugswissenschaften (Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaft, Theologie, Archäologie, Psychologie, Visuelle Kommunikation, Lehramt (Kunstpädagogik) können Veranstaltungen nach Absprache mit den Modulverantwortlichen auch in anderen Fachbereichen belegt werden.
Dauer und Frequenz des Moduls	Das Modul ist innerhalb des Grundstudiums zu absolvieren. Es wird regelmäßig angeboten.
Sprache	Deutsch
Voraussetzungen für die Teilnahme	Immatrikulation in einem einschlägigen Studiengang der Uni Kassel
Lehr- und Lernformen	a. Vorlesung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung b. Grundseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung, Übernahme eines Referat; Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit oder Portfolio
Studentischer Arbeitsaufwand	a.Vorlesung: 30h Präsenzzeit + 90h Eigenstudium / 2 SWS: 4c b.Grundseminar: 30h Präsenzzeit + 90h Selbststudium + 60h Referat + 90h Hausarbeit/Portfolio/ 2 SWS: 9c
Arbeitsaufwand	

des gesamten Moduls	390h / 4 SWS
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	13c (davon 2c für SK)
1. Modul-Prüfungsleistungen	1.Hausarbeit oder Portfolio 2.Referat
2.Studienleistungen	Die Modulnote ist die Modulprüfungsleistung.

<b>Modul V</b>	<b><u>Theorie und Geschichte der Kunstwissenschaft</u></b> Pflichtmodul Grundlagen Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Stefan Majetschak Lehrende des Moduls: Majetschak, ggf Hemken, ggf N.N., ggf Sitt, ggf. Mittelbau
Veranstaltungen	Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor: a. Vorlesung b. Grundseminar c. Hauptseminar
Kompetenzen	Nicht zuletzt unter dem Einfluss von Hegels philosophischer Deutung der Kunstgeschichte etabliert sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigenständige akademische Disziplin gleichen Namens. An Hegels methodische Zugangsweise zur Kunst fühlte sie sich freilich schon bald nicht mehr gebunden. In unterschiedlichem Maße den herrschenden philosophischen Strömungen ihrer Zeit verpflichtet, entwickelte sie vielmehr schon bald aus spezifisch kunsthistorischer Sicht eigenständige Theorieansätze. Mit den Namen Jakob Burckhardt und Konrad Fiedler, Heinrich Wölfflin und Alois Riegel, Aby Warburg, Erwin Panofsky, Max Raphael oder Hans Sedlmayr sind einige der Stationen auf dem Wege der kunstwissenschaftlichen Methodenreflexion benannt. Bei der analysierenden Betrachtung der o.g. Theorieansätze ist es unerlässlich, den historischen Vorläufern wie die kunstkritischen Einlassungen von Plinius und Vitruv, den Künstlerviten von Giorgio Vasaris, Carel van Mander und Joachim van Sandrart, den Kunsttheorien der späten Neuzeit etwa eines A. Félibien und nicht zuletzt den Darlegungen eines J.J. Winckelmann oder eines F. von Rumohr Beachtung zu schenken. Das Modul vermittelt einen Überblick über die Hauptstationen auf diesem Weg und macht die Studierenden exemplarisch mit den wichtigsten Einzelpositionen bekannt. Es verfolgt das Ziel, das Bewußtsein der Studierenden um die fachspezifischen Methodenprobleme durch die Kenntnis von methodologischen Alternativen zu schärfen. Schlüsselkompetenzen (20%): ISK: Textanalyse (Primär- und Sekundärquellen), Objekt- und Prozessanalyse (bildende und angewandte Kunst, Architektur), Methodenanwendung, wissenschaftliche Recherche, interdisziplinäres Arbeiten ASK: EDV-Kenntnisse, Vermittlungskompetenz
Verwendbarkeit des Moduls	B.A.–Kunstwissenschaft: Pflichtbereich Im Rahmen der Bezugswissenschaften (Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaft, Theologie, Philosophie, Psychologie) können Veranstaltungen nach Absprache mit den Modulverantwortlichen auch in anderen Fachbereichen

	belegt werden.
Dauer und Frequenz des Moduls	Das Modul ist innerhalb des Hauptstudiums zu absolvieren und dauert ein Semester. Es wird regelmäßig angeboten.
Sprache	Deutsch
Voraussetzungen für die Teilnahme	Immatrikulation in einem einschlägigen Studiengang der Uni Kassel
Lehr- und Lernformen	a. Vorlesung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung b. Grundseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Übernahme eines Referates c. Hauptseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Übernahme eines Referates, Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit
Studentischer Arbeitsaufwand	a. Vorlesung: 30h Präsenzzeit + 90h Eigenstudium, / 2 SWS: 4c b. Grundseminar: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 30h Kurzreferat + 60h AG / 2 SWS: 6c c. Hauptseminar: 30h Präsenzzeit + 90h Selbststudium + 60h Referat oder AG + 60h Hausarbeit / 2 SWS: 8c
Arbeitsaufwand des gesamten Moduls	540h / 6 SWS
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	18c (davon 2c für SK)
1. Modul(teil)-Prüfungsleistungen  2. Studienleistungen	1.Hausarbeit  2. AG (Grundseminar b) Referat (Grundseminar b) Referat oder AG (Hauptseminar c)  Die Modulnote ist die Modulprüfungsleistung.

<b>Modul VI</b>	<p><b><u>Kunstwissenschaftliche Probleme der künstlerischen Praxis</u></b></p> <p>Pflichtmodul Vertiefung  Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Kai-Uwe Hemken  Lehrende des Moduls: Hemken, Majetschak, Sitt, N.N., Mittelbau, Lehrbeauftragte</p>
Veranstaltungen	<p>Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor:</p> <p>a. Seminar  b. Vortragsreihe KHK</p>
Kompetenzen	<p>Seit dem 15. Jahrhundert haben sich Künstler wie Leon Battista Albert oder Albrecht Dürer über die künstlerische Praxis in Traktaten, (pseudo-)wissenschaftlichen Abhandlungen, Manifesten oder privaten Schriftzeugnissen dezidiert geäußert. Sie haben nicht nur Auskunft über die handwerkliche Verwendung von Materialien, Farben usw. gegeben, sondern zugleich die künstlerische Behandlung des literarischen Stoffes mit Blick auf eine optimierte Wirkung entworfen. Ein weiterer Zweig der Forschung stellt die Verbindung zwischen optischen Medien bzw. bildgebenden Verfahren (Perspektive, Camera obscura, Camera lucida usw.) und der Kunst dar, die im Verlauf von Jahrhunderten bei Künstlern wie Jan van Eyck, Vermeer oder Canaletto eine Rivalität und Verbrüderung eingingen. Ein Regelwerk der Auftraggeber (Staat, Hof, Kirche, Gesellschaft) manifestierte im Dienste der Repräsentation und Ideologisierung weitergehende Maßgaben der künstlerischen Praxis.</p> <p>Zugleich wurde mit der Einrichtung von Kunstakademien seit dem 15. Jahrhundert die Systematisierung der künstlerischen Praxis institutionalisiert und war fortan mit einer größeren Breitenwirkung ausgestattet.</p> <p>Die Kunst des 20. Jahrhunderts hat sich – unter dem Leitmotiv ‚Avantgarde‘ – von jeglichem offiziellen Regelwerk der künstlerischen Praxis losgesagt. Die Grenzen zwischen Kunstsphäre und Alltagswelt wurden durchlässig, so dass eine Vielzahl neuer ehemals ‚kunstunwürdiger‘ Materialien und Verfahren zur Anwendung gekommen sind. Die Art und Weise der künstlerischen Praxis und ihre theoretische Reflexion seitens der Künstlerschaft gilt es, in ihrer individuellen Erscheinungsform und in Wechselwirkung zu mittelbaren und unmittelbaren Entstehungs- und Funktionskontexten zu ergründen. Eine Historisierung ist ebenso erforderlich wie eine Betrachtung von Leitmodi der Kunstentwicklung über längere geschichtliche Zeiträume hinweg.</p> <p>Schlüsselkompetenzen (30%):  ISK: Textanalyse (Primär- und Sekundärquellen), Objekt- und Prozessanalyse (bildende und angewandte Kunst, Architektur), Methodenanwendung, wissenschaftliche Recherche, interdisziplinäres Arbeiten  ASK: EDV-Kenntnisse, Vermittlungskompetenz, Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Sozialkompetenz.</p> <p>Im Rahmen dieses Moduls kann der Werkstatt- und Praktikumsnachweis erworben werden.</p>
Verwendbarkeit des Moduls	<p>B.A.– Studium Kunstwissenschaft: Pflichtbereich</p> <p>Im Rahmen der Bezugswissenschaften (Literaturwissenschaft, Philosophie, Psychologie, Lehramt (Kunstpädagogik) können Veranstaltungen nach Absprache mit den Modulverantwortlichen auch in anderen Fachbereichen belegt werden.</p>
Dauer und Frequenz des Moduls	<p>Das Modul wird regelmäßig angeboten.</p>
Sprache	<p>Deutsch</p>

Voraussetzungen für die Teilnahme	Immatrikulation in einem einschlägigen Studiengang der Uni Kassel Erfolgreiche Teilnahme an den Modulen I-V
Lehr- und Lernformen	a. Seminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Übernahme eines Kurzreferates b. Vortragsreihe (KHK): aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung; Anfertigung eines schriftlichen Berichts oder schriftlicher Protokolle
Studentischer Arbeitsaufwand	a. Seminar: 30h Präsenzzeit + 60h Eigenstudium + 30h Kurzreferat / 2 SWS: 4c b. Vortragsreihe (KHK): 30h Präsenzzeit + 30h Selbststudium + 60h schriftlicher Bericht oder Protokolle / 2 SWS: 4c
Arbeitsaufwand des gesamten Moduls	240h / 4 SWS
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	8c (davon 1c für SK)
1. Modul-Prüfungsleistungen	1. Bericht oder Protokolle (Vortragsreihe KHK)
2. Studienleistungen	2. Kurzreferat (Seminar a)
	Die Modulnote ist die Modulprüfungsleistung.

<b>Modul VII</b>	<b><u>Kultur / Sprache / Kommunikation</u></b>  Pflichtmodul Vertiefung Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Stefan Majetschak Lehrende des Moduls: Majetschak, Hemken, Sitt, N.N., Mittelbau, Lehrbeauftragte
Veranstaltungen	Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor: a. Vorlesung b. Hauptseminar
Kompetenzen	Das Modul widmet sich den Problemfeldern von Kultur, Sprache und Kommunikation als den nicht-naturalen Konstituentien menschlicher Sozialität. Dabei sollen die Studierenden Überblickskenntnisse über die seit etwa 1600 bis zur Gegenwart in der Philosophie sowie in den beteiligten Einzelwissenschaften entwickelten Kultur- und Sprachtheorien erwerben sowie in mindestens einer Veranstaltung auch an aktuelle Forschungsthemen zu unterschiedlichen kulturellen Kommunikationsformen herangeführt werden (Sprache vs. Bild, Medienspezifität von Kommunikationsformen, Kulturelle Umschichtungen durch ‚Neue Medien‘, etc.). Das Modul umfasst Veranstaltungen über Kultur-, Sprach- und Kommunikationstheorie in historischer oder systematischer Perspektive, die auch in den Studiengängen der Bezugswissenschaften dieses Moduls an der Universität Kassel absolviert werden können (Semiotik, Sprach- und Literaturwissenschaft, Philosophie etc.). Schlüsselkompetenzen (10%): ISK: Textanalyse (Primär- und Sekundärquellen), Objekt- und Prozessanalyse (bildende und angewandte Kunst, Architektur), Methodenanwendung, wissenschaftliche Recherche, interdisziplinäres Arbeiten ASK: EDV-Kenntnisse, Vermittlungskompetenz
Verwendbarkeit des Moduls	B.A.-Studium Kunstwissenschaft Im Rahmen der Bezugswissenschaften (Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaft, Theologie, Philosophie, Psychologie, Lehramt (Kunstpädagogik) können Veranstaltungen nach Absprache mit den Modulverantwortlichen auch in anderen Fachbereichen belegt werden.
Dauer und Frequenz des Moduls	Das Modul ist nach Möglichkeit innerhalb des späten Hauptstudiums zu absolvieren und dauert ein Semester. Es wird regelmäßig angeboten. Das Modul kann auch in den inhaltlich entsprechenden Bezugswissenschaften erfolgreich abgeschlossen werden. Hier bedarf es einer Abstimmung mit dem Modulverantwortlichen, soweit es nicht bereits als Moduläquivalent angekündigt wurde.
Sprache	Deutsch
Voraussetzungen für die Teilnahme	Immatrikulation in einem einschlägigen Studiengang der Uni Kassel Erfolgreiche Teilnahme an folgenden Modulen I-V
Lehr- und Lernformen	a. Vorlesung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung b. Hauptseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung, Übernahme eines Referates; Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit oder Portfolio; Tutorium
Studentischer Arbeitsaufwand	a. Vorlesung: 30h Präsenzzeit + 90h Eigenstudium / 2 SWS: 4c b. Hauptseminar: 30h Präsenzzeit + 60h Selbststudium + 60h Referat + 60 h Hausarbeit/Portfolio / 90h Tutorium / 2 SWS: 10c
Arbeitsaufwand des	

gesamten Moduls	420h / 4 SWS
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	14c (davon 2c für SK)
1. Modul(teil)-Prüfungsleistungen 2. Studienleistungen	1.Hausarbeit 2.Referat (Hauptseminar b) Tutorium (Hauptseminar b)  Die Modulnote ist die Modulprüfungsleistung.

<b>Modul VIII</b>	<b><u>Wissenschaft, Kunst und Kunstbetrieb</u></b> (Geschichte und Gegenwart)  Pflichtmodul Vertiefung Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Kai-Uwe Hemken Lehrende des Moduls: Hemken, Majetschak, Sitt, N.N., Mittelbau, Lehrbeauftragte
Veranstaltungen	Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor: a. Vorlesung b. Projektseminar
Kompetenzen	Die Ausformung der Kunstgeschichte/Kunstwissenschaft als souveräne Disziplin ist das Resultat sowohl von wissenschaftsinternen Prozessen als auch von äußeren Einflußfaktoren, zu denen nicht nur benachbarte Sphären wie die Philosophie, Literatur oder Geschichte, sondern auch gesellschaftspraktische Entwicklungen wie die Etablierung eines Ausstellungswesens oder des Museums als Bildungsstätte gehören. Fragen der Kunstkritik, der kunstkritischen Analyse von Kunst, des Ankaufswesens der Frühzeit bis zur Gegenwart (Mäzenatentum bis öffentlicher Auftrag) werden hier in den unterschiedlichen Epochen zur Sprache gebracht.  Die Wechselwirkungen zwischen der Kunstwissenschaft und dem Kunstbetrieb im weitesten Sinne sind somit nicht rein berufspraktisch orientiert, sondern historisch verbürgt. Hier standen ein sich allmählich ausformender Kanon von Bewertungskriterien für Kunst ebenso Pate wie die Wertschätzung der Museumsleitung, die den öffentlichen Besitz mit einer sachbezogenen Ankaufspolitik vermehrte.  Für eine praxisorientierte Ausbildung ist es daher unerlässlich, die Strukturen und Kausalitäten des Kunstbetriebs in Vergangenheit und Gegenwart zu erschließen.  Schlüsselkompetenzen (20%): ISK: Textanalyse (Primär- und Sekundärquellen), Objekt- und Prozessanalyse (bildende und angewandte Kunst, Architektur), Methodenanwendung, wissenschaftliche Recherche, interdisziplinäres Arbeiten ASK: EDV-Kenntnisse, Vermittlungskompetenz, Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Sozialkompetenz, Vermittlungskompetenz Im Rahmen dieses Moduls kann der Werkstatt- und Praktikumsnachweis erworben werden.
Verwendbarkeit des Moduls	B.A.-Studium Kunstwissenschaft: Pflichtbereich Im Rahmen der Bezugswissenschaften (Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaft, Pädagogik, Lehramt (Kunstpädagogik) können Veranstaltungen nach Absprache mit den Modulverantwortlichen auch in anderen

	Fachbereichen belegt werden.
Dauer und Frequenz des Moduls	Das Modul ist innerhalb des fortgeschrittenen Hauptstudiums zu absolvieren und erstreckt sich in der Regel über ein bis zwei Semester. Es wird regelmäßig angeboten. Das Modul kann auch in einer entsprechenden Bezugswissenschaft erfolgreich abgeschlossen werden.
Sprache	Deutsch
Voraussetzungen für die Teilnahme	Immatrikulation in einem einschlägigen Studiengang der Uni Kassel
Lehr- und Lernformen	a. Vorlesung: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung b. Projektseminar: aktive Teilnahme; eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung, Anfertigung eines Berichts oder Portfolio
Studentischer Arbeitsaufwand	a. Vorlesung: 30h Präsenzzeit, 90h Eigenstudium / 2 SWS: 4c b. Projektseminar: 120h Präsenzzeit + 150h Selbststudium + 60h Portfolio o. Bericht + 6 SWS: insg. 11c
Arbeitsaufwand des gesamten Moduls	450h / 8 SWS
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	15c (davon 4c für SK)
1. Modul-Prüfungsleistungen	1.Portfolio o. Bericht (Projektseminar)
2.Studienleistungen	Die Modulnote ist die Modulprüfungsleistung.

<b>Modul IX</b>	<b><u>Additive Schlüsselkompetenzen</u></b> Pflichtmodul Modulverantwortlicher: N.N.
Veranstaltungen	Das Modul sieht in der Regel folgende Lehrveranstaltungen vor: a1.Praktikum <b>oder</b> a2.Werkstattprojekt <b>oder</b> a3. Tutoriumsleitung
Studentischer Arbeitsaufwand	a1.Praktikum: 300h Präsenzzeit + 30h Selbststudium + 30h Bericht / 12 SWS <b>oder</b> a2. Werkstattprojekt: 300h Präsenzzeit + 30h Selbststudium + 30h Bericht / 12 SWS: jeweils 12c a3.Tutoriumsleitung: 30h Präsenzzeit + 300h Selbststudium + 30h Konzeptpaper / 2 SWS: 12c
Arbeitsaufwand des gesamten Moduls	360h / 12 SWS / 2 SWS bei Tutorium
Anzahl der Credits des gesamten Moduls	12c
1. Modul-Prüfungsleistungen 2. Studienleistungen	1. Bericht (Praktikum a1 oder Werkstattprojekt a2) oder Konzeptpaper (Tutorium a3) 2. Die Modulnote ist die Modulprüfungsleistung.

<b>Modul X</b>	<b><u>Bachelormodul</u></b>
Veranstaltungen	Bachelorarbeit Bachelorkolloquium
Kompetenzen	
Verwendbarkeit des Moduls	B.A.-Studium Kunstwissenschaft
Dauer und Frequenz des Moduls	1 Sem., semesterweise.
Sprache	Deutsch
Voraussetzungen für die Teilnahme	Immatrikulation im Bachelor Kunstwissenschaft Bestandene Module I - VIII und abgeleitetes Praktikum bzw. Werkstattprojekt
Lehr- und Lernformen	
Studentischer Arbeitsaufwand	Bachelorarbeit 6 Wochen / 180h Kolloquium inkl. Vorbereitung 180h
Anzahl der Credits	12 c
1. Modul-Prüfungsleistungen	Bachelorarbeit Kolloquium
2. Studienleistungen	Die Bachelorarbeit geht mit 70 %, das Kolloquium mit 30 % in die Modulnote ein.

**Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang English and American Culture and Business Studies/Anglistik, Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Kassel vom 23. November 2011**

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang English and American Culture and Business Studies/Anglistik, Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Kassel vom 16. Juni 2010 (Mittbl. 16/2010, S. 1866) wird wie folgt geändert:

**Artikel 1 Änderungen**

1. Im Modulhandbuch wird das Modul [BA 21] Prüfungsmodul wie folgt gefasst:

Modulname	[BA21] Prüfungsmodul
Lehrveranstaltungen	--
Lerninhalte, Qualifikationsziel	Lerninhalt: Selbstständige Anwendung des im Rahmen des Studiums erworbenen Fachwissens auf eine konkrete wissenschaftliche Fragestellung Qualifikationsziel: Nachweis der Befähigung zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten
Verwendbarkeit des Moduls	B.A. English and American Studies / Anglistik und Amerikanistik B.A. English and American Culture and Business Studies / Anglistik, Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften
Dauer und Häufigkeit des Angebotes des Moduls	Dauer: 1 Semester
Sprache	--
Voraussetzung für Teilnahme	Gem. Prüfungsordnung
Lehr- /Lernform	--
Studentischer Arbeitsaufwand	360h
Modulprüfungsleistung	Bachelorarbeit gem. Prüfungsordnung  <i>Wird das Prüfungsmodul im Bereich "Wirtschaftswissenschaften" abgelegt, gilt:</i> Kumulierte Modulprüfungsleistung Modulprüfungsleistungen: Bachelorarbeit (75%) Bachelorkolloquium (25%)
Anzahl Credits für das Modul	12

**Artikel 2 In-Kraft-Treten**

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Universität Kassel in Kraft.

Kassel, den 05. April 2012

Die Dekanin des Fachbereichs Geistes- und Kulturwissenschaften  
Prof. Dr. Petra Freudenberger-Lötz

**Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang English and American Culture and Business Studies/Anglistik und Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Kassel vom 23. November 2011**

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang English and American Culture and Business Studies / Anglistik und Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Kassel vom 16. Mai 2007 (Mittbl. 13/2008, S. 932) wird wie folgt geändert:

**Artikel 1 Änderungen**

Ein neuer § 11 wird eingefügt und wie folgt gefasst:

„§ 11 Außer-Kraft-Treten

Diese Prüfungsordnung tritt mit Ablauf des 30. September 2012 außer Kraft.“

**Artikel 2 In-Kraft-Treten**

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Universität Kassel in Kraft.

Kassel, den 05. April 2012

Die Dekanin des Fachbereichs Geistes- und Kulturwissenschaften  
Prof. Dr. Petra Freudenberger-Lötz

**Fachprüfungsordnung für den Masterstudiengang Optical Nano Technologies Engineering (ONTE) des  
Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik der Universität Kassel vom 26. Januar 2012**

**I. Allgemeine Bestimmungen**

- § 1 Geltungsbereich
- § 2 Akademischer Grad
- § 3 Regelstudienzeit, Umfang des Studiums, Studienbeginn
- § 4 Prüfungsausschuss

**II. Masterabschluss**

- § 5 Zulassungsvoraussetzungen
- § 6 Prüfungsteile des Masterabschlusses
- § 7 Masterarbeit mit Kolloquium
- § 8 Benotung der Module und Gesamtnote

**III. Schlussbestimmung**

- § 9 In-Kraft-Treten

**Anlagen**

- Modulplan
- Modulhandbuch

## I. Allgemeine Bestimmungen

### § 1 Geltungsbereich

Die Fachprüfungsordnung des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik für den konsekutiven englischsprachigen Masterstudiengang Optical Nano Technologies Engineering ergänzt die Allgemeinen Bestimmungen für Fachprüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master (AB Bachelor/Master) der Universität Kassel in der jeweils geltenden Fassung.

### § 2 Akademischer Grad

Der Masterstudiengang Optical Nano Technologies Engineering ist forschungsorientiert. Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der akademische Grad „Master of Science“ (M.Sc.) durch den Fachbereich Elektrotechnik/Informatik verliehen.

### § 3 Regelstudienzeit, Umfang des Studiums, Studienbeginn

(1) Die Regelstudienzeit für das Masterstudium beträgt drei Semester einschließlich der Masterarbeit und des Masterkolloquiums.

(2) Im Masterstudium werden 90 Credits erlangt, davon 30 Credits für die Masterarbeit einschließlich des Masterkolloquiums.

(3) Das Masterstudium kann zum Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden.

### § 4 Prüfungsausschuss

(1) Die Entscheidungen in Prüfungsangelegenheiten trifft der Prüfungsausschuss für Optical Nano Technologies Engineering.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:

- drei Professorinnen oder Professoren,
- eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie
- eine Studierende oder ein Studierender des Masterstudiengangs Optical Nano Technologies Engineering.

## II. Masterabschluss

### § 5 Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zum Masterstudium kann nur zugelassen werden, wer:

a) die Bachelorprüfung an einer Saudi-Arabischen Universität, der Universität Kassel oder einer anderen Hochschule im Studiengang Elektrotechnik, Maschinenbau, Chemie, Physik oder Nanostrukturwissenschaften mit einer Regelstudienzeit von mindestens sieben Semestern und 210 Credits bestanden hat, oder

b) einen fachlich gleichwertigen Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau, Chemie, Physik oder Nanostrukturwissenschaften einer anderen Hochschule mit einer Regelstudienzeit von mindestens sieben Semestern und 210 Credits erworben hat.

Bewerber gemäß lit. a und b, die einen sechssemestrigen Bachelor (180 Credits) vorweisen, haben Auflagen gemäß § 5 Abs. 5 zu erfüllen.

(2) Das fachliche Profil des Studienabschlusses gem. Abs. 1 muss den Anforderungen des Masterstudiengangs Optical Nano Technologies Engineering entsprechen. Die Basisvoraussetzungen sind Grundkenntnisse der Differentialgleichungen, der Physik, und der anorganischen Chemie bzw. gegebenenfalls von anderslautenden Fächern, welche aber diese Inhalte enthalten im Umfang von zusammen 20 Credits im Bachelor Kurs. Das Vorliegen der Voraussetzungen ist in einem Motivationsschreiben zu begründen und mit den Bewerbungsunterlagen einzureichen. Das Motivationsschreiben soll auf die vorhandenen Grundkenntnisse in der Optik, der Halbleiterelektronik, der Materialwissenschaft und der Mathematik eingehen. Ferner beschrieben werden sollen die Erwartungen an die im Masterkurs zu erlernende auf die Nanotechnologie ausgerichtete ingenieurtechnische Methodik, sowie Themen optischer Technologien und Anwendungsaspekte.

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen gem. Abs. 2 wird vom Prüfungsausschuss wie folgt festgestellt:

- entweder aufgrund eines internetbasierten Screenings sowie der schriftlich begründeten Bewerbungsunterlagen. In Zweifelsfällen kann darüber hinaus aufgrund eines Beschlusses des Prüfungsausschusses ein Auswahlgespräch von 30 Minuten Dauer durchgeführt werden. Für das Auswahlgespräch bestellt der Prüfungsausschuss zwei Professorinnen oder Professoren.
- oder im Falle von Saudi-Arabischen Studierenden durch Auswahl durch einen vom Prüfungsausschuss bestimmten Prüfer der KACST in Riyadh anhand der schriftlich begründeten Bewerbungsunterlagen. In Zweifelsfällen kann darüber hinaus ein Auswahlgespräch von 30 Minuten Dauer durchgeführt werden. Für das Auswahlgespräch bestellt der Prüfungsausschuss zwei Professorinnen oder Professoren.

(4) Des Weiteren sind ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache nachzuweisen. Für Bewerberinnen und Bewerber ist ein entsprechender Nachweis gegeben, falls

a) Englisch die Muttersprache ist oder

b) wenn das bisherige Studium vollständig englischsprachig war oder

c) der Nachweis des Niveaus B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens durch ein Sprachzertifikat (z.B. TOEFL, IELTS) erbracht ist.

5) Fehlen der Bewerberin oder dem Bewerber Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstudium (z.B. nur 180 vorhandene Credits aus dem Bachelor Studiengang, oder nicht ausreichende fachliche Voraussetzungen), kann der Prüfungsausschuss die Zulassung unter der Auflage aussprechen, dass bis zur Anmeldung der dritten Klausur aus den Modulen R1 bis R5 die fehlenden Kenntnisse durch erfolgreiches Absolvieren von Modulen im Umfang von maximal 30 Credits aus der folgenden Liste nachgewiesen werden:

Modultitel	Credits
Electromagnetics and optics Q1	9
Mathematics Q2	6
Engineering Physics, Materials and Chemistry Q3	8
Fundamentals of Signal Processing and Communications Q4	5
Language Course Technical English Q5	2
Optical Communication Systems Q6	4
Safety and Computer Architecture Q7	4

(6) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss von Abs. 2 abweichende Entscheidungen treffen. Ausnahmen können z.B. sein, eine Berufserfahrung von mehr als 1/2 Jahr in einem ingenieurtechnischen Betrieb; ein technisches Praktikum in einem Labor von mehr als 1 Monat Dauer, das sich z.B. mit Halbleitertechnologie, Optik, Materialwissenschaften, physikalischer Chemie, Bauelementen oder optischen Systemen beschäftigt; eine andere herausragende Qualifikation im naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich; eine Qualifikation die als vergleichbar begründet werden kann; oder ein besonders gutes Motivationsschreiben.

### § 6 Prüfungsteile des Masterabschlusses

(1) Der Masterabschluss umfasst die folgenden Prüfungsteile:

1. Studienbegleitende Modulprüfungen im Umfang von 60 Credits in folgenden Modulen:

Modultitel	Credits
Nanophotonic Devices and Components R1	13
Software Components for Communication Systems R2	8
Computational Design of Photonic Devices R3	4
Nanosystem Technology, Fabrication Aspects R4	8
Optical Communication Systems and ONTE Seminar R5	6
Practical Training 1: Nanophotonic Devices and Components P1	6
Practical Training 2: Clean Room Technologies P2	15

2. Eine Masterarbeit gem. § 7 im Umfang von 30 Credits einschließlich des Kolloquiums aus den nachfolgenden Modulen:

Modultitel	Credits
Optoelectronics T1	30
Electromagnetic Nanoscience T2	30
Optical Communication Systems T3	30
Digital Communications T4	30
Functional Safety T5	30

(2) Nicht bestandene Modulprüfungen außer dem Masterabschlussmodul können im Prüfungszeitraum nach Ende jedes Semesters wiederholt werden. Wird eine Teilprüfung eines Moduls nicht bestanden, so muss lediglich diese Teilprüfung wiederholt werden.

### § 7 Masterarbeit mit Kolloquium

(1) Das Thema der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn die Modulprüfungsleistungen gem. § 6 Abs. 1 im Umfang von insgesamt 54 Credits erbracht sind.

(2) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt sechs Monate und beginnt mit dem Tag der Bekanntgabe des Themas durch den Prüfungsausschuss. Das Thema muss so beschaffen sein, dass es innerhalb der vorgesehenen Frist bearbeitet werden kann.

(3) Kann der Abgabetermin aus Gründen, die die Kandidatin oder der Kandidat nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden, so verlängert der Prüfungsausschuss einmal die Bearbeitungszeit um maximal 3 Monate, wenn die Kandidatin oder der Kandidat dies vor dem ersten Abgabetermin beantragt und die Betreuerin oder der Betreuer zustimmt.

(4) Die Masterarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen schriftlichen Exemplaren und einer elektronischen Fassung beim Prüfungsausschuss abzugeben.

(5) Die Masterarbeit ist im Rahmen eines Masterkolloquiums vorzustellen. An dem Kolloquium nehmen außer dem Kandidaten der Erstgutachter und ein Zweitgutachter teil. Das Masterkolloquium soll spätestens 10 Wochen nach Abgabe der Masterarbeit erfolgen. Die Teilnahme am Masterkolloquium setzt voraus, dass in der Masterarbeit mindestens die Note „ausreichend“ erzielt wurde. Die Dauer beträgt für das gesamte Kolloquium maximal 60 Minuten.

(6) Mindestens einer der Prüfer der Masterarbeit stammt aus dem Kreis der für den Studiengang verantwortlichen hauptamtlichen Hochschullehrer.

(7) Um die Masterprüfung zu bestehen, müssen Masterarbeit und Masterkolloquium jeweils mindestens mit „ausreichend“ bewertet worden sein.

(8) Die Gesamtnote der Masterarbeit ergibt sich aus der Bewertung der schriftlichen Arbeit (Gewichtung: 3/4) und aus der Bewertung des Kolloquiums (Gewichtung: 1/4). Ein nicht mindestens mit „ausreichend“ bewertetes Kolloquium kann einmal wiederholt werden. Bei der Wiederholung des Kolloquiums muss auch der Zweitprüfer anwesend sein. Wird auch das Wiederholungskolloquium mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ zu bewerten und nicht bestanden.

(9) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit dem ersten Prüfer bzw. der ersten Prüferin und dem zweiten Prüfer bzw. der zweiten Prüferin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden (Externe Masterarbeit). In diesem Fall müssen der erste Prüfer bzw. die erste Prüferin und der zweite Prüfer bzw. die zweite Prüferin Mitglied im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik sein. Die Regelungen der Artikel 1–8 gelten auch für externe Masterarbeiten.

### § 8 Benotung der Module und Gesamtnote

(1) Die Gesamtnote eines Moduls ergibt sich aus dem mit den Credits gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Modulteilprüfungen. Jede Modulteilprüfung muss mit mindestens „ausreichend“ bewertet sein.

(2) Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich aus dem mit den Credits gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Module gem. § 6.

### **III. Schlussbestimmungen**

#### **§ 9 In-Kraft-Treten**

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Universität Kassel in Kraft.

Kassel, den 23. März 2012

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik  
Prof. Dr. sc. techn. Dirk Dahlhaus

## Anlage 1: Modulplan

3.Sem.	Master Thesis				30 C
2. Sem.	R 4: Nanosystem Technology, Fabrication Aspects 8 C	P 2: Practical Training 2: Clean Room Technologies 15 C (Key Competences)	R 5: Optical Communication Systems and ONTE Seminar 6 C		29 C
1.Sem.	R 1: Nanophotonic Devices and Components 13 C	P 1: Practical Training 1: Nanophotonic Devices and Components 6 C	R 2: Software Components for Communication Systems 8 C	R 3: Computational Design of Photonic Devices 4 C	31 C

**Modulhandbuch für den Masterstudiengang  
Optical Nano Technologies Engineering (ONTE)  
des Fachbereiches Elektrotechnik/Informatik  
der Universität Kassel**

**Stand: 23.03.2012**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Module des ONTE–Masterstudiengangs .....</b>	<b>1148</b>
Reguläre Module.....	1149
Module Practical Training.....	1162
Thesenmodule.....	1166
<b>Qualifikationsmodule.....</b>	<b>1173</b>

## Module des ONTE-Masterstudiengangs

In diesem Abschnitt werden alle Module aufgeführt, die im Rahmen des ONTE-Masterstudiengangs belegt werden können. Die Module sind thematisch in folgenden Bereichen angesiedelt:

- Nanophotonic Devices and Components
- Software Components for Communication Systems
- Electromagnetic Nanoscience
- Nanosystem Technology, Fabrication Aspects
- Optical Communication Systems and ONTE Seminar
- Clean Room Technology.

Innerhalb eines Bereichs gilt die folgende Namenskonvention: Die Bezeichnung eines Moduls, wie z.B. *Nanophotonic Devices and Components R1*, ergibt sich aus <BEREICH TYP NR>. Während BEREICH und NR einen der o.g. Bereiche bzw. eine laufende Nummer bezeichnen, ergeben sich für TYP die folgenden Werte:

- R** reguläres Modul, bestehend aus Vorlesungen, Übungen, Seminaren  
**P** Practical Training.

Die Module der Masterarbeit, nachfolgend Thesenmodule genannt, können aus den folgenden Thesenbereichen gewählt werden:

- Digital Communications
- Electromagnetic Nanoscience
- Functional Safety
- Optical Communication Systems
- Optoelectronics.

Die Bezeichnung des Thesenmoduls, wie z.B. *Optoelectronics T1*, ergibt sich aus <BEREICH T NR>, wobei BEREICH einen der o.g. Thesenbereiche bezeichnet und NR eine laufende Nummer bedeutet.

## Reguläre Module

Modultitel	Nanophotonic Devices and Components R1				
	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
Lehrveranstaltungen	Optoelectronic devices (lec)	Vorlesung	3	4	30-minütige mündliche Prüfung
	Optoelectronic devices (ex)	Übung	1	1	
	Semiconductor lasers (lec)	Vorlesung	3	4	
	Semiconductor lasers (ex)	Übung	1	1	
	Nanophotonic sensorics (lec)	Vorlesung	2	3	15-minütige mündliche Prüfung
	Credits für das Gesamtmodul	13			
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Wintersemester, jährlich				
Dozent(en)	Hillmer und Mitarbeiter				
Verantwortliche(r)	Hillmer				
Teilnahmevoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagenwissen der elektronischen Bauelemente bzw. der Halbleiterelektronik, Grundlagen der Materialkunde</li> <li>▪ Mathematische Kenntnisse der Analysis und Vektoralgebra</li> </ul>				
Arbeitsaufwand	120 Stunden Präsenzzeit 180 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wiederholung der Grundlagen der Strahlen-, Wellen- und Quantenoptik,</li> <li>▪ Einführung in die Grundprinzipien der Nanostrukturwissenschaften und der Nanotechnologie</li> <li>▪ Wiederholung der Grundlagen der Optik: Brechungsindex, Polarisierung, Interferenz, Beugung, Brechung, optische Kohärenz.</li> <li>▪ Beispielhaft am Brechungsindex, der Beugung und der Brechung wird die Verbindung von phänomenologischen makroskopischen Modellen und nanoskalierten Vorgängen und Modellen anschaulich Schritt für Schritt erarbeitet.</li> <li>▪ Dielektrische Materialeigenschaften (z.B. Glas): Real- und Imaginärteil des Brechungsindex, Material-Dispersion, Absorption</li> <li>▪ Optische Wellenleiter mit detaillierter Einführung in Dispersion (Modendispersion, Materialdispersion, Wellenleiterdispersion, u.a.), Dämpfung (Absorption), Filmwellenleiter, vergrabene planare und zirkulare Wellenleiter</li> <li>▪ Einführung in eine nanotechnologische Sichtweise der Phänomene:</li> </ul>				

	<p>Aufzeigen der Parallelen zwischen den Problemen; (i) Elektronenwellen in Potentialverläufen, hier Halbleiter-Heterostrukturen und (ii) Lichtwellen in Brechungsindexverläufen, hier dielektrischen Heterostrukturen. Dabei werden aus nanotechnologischer Sicht die Parallelen und die Unterschiede der Eigenwerte und Eigenfunktionen der (i) Schrödinger-Gleichung und der (ii) Helmholtz-Gleichung aufgezeigt. Hierzu: Betrachtung von Optik, Elektronik, Akustik und Mikrowellen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interferometer (Michelson, Fabry-Pérot, Mach-Zehnder) Anwendung dieser nanotechnologischen Strukturen für die Sensorik,</li> <li>▪ Optische Mehrschichtstrukturen (z.B. DBR-Spiegel)</li> <li>▪ Einführung in eine nanotechnologische Sichtweise der Phänomene: Aufzeigen der Parallelen zwischen den Problemen; (i) Elektronenwellen in periodischen Potentialverläufen und (ii) Lichtwellen in periodischen Brechungsindexverläufen. Dabei werden aus nanotechnologischer Sicht die Parallelen und die Unterschiede der Welleninterferenz, Reflexion und Transmission verdeutlicht.</li> <li>▪ Einführung in Laser, LEDs, Photodioden und Solarzellen. Parallelen und Unterschiede aus nanotechnologischer Sicht. Aufzeigen von spiegelbildlichen Funktionen und Aufbau bezüglich elektronischen und optischen Anteilen.</li> <li>▪ Beugungselemente: ein-, zwei- und dreidimensionale Gitter, Fresnellinsen und photonische Kristalle. Aufzeigen von Analogien und Unterschieden bezüglich photonischer und elektronischer Kristalle aus nanotechnologischer Sicht</li> <li>▪ Lasergrundlagen: Gewinn, Ratengleichung, DFB-Gitter, Spektren, kantenemittierende und oberflächenemittierende Laser. Horizontale und vertikale Resonatorstrukturen aus nanotechnologischer Sicht zur Verdeutlichung analoger Phänomene in der Optik und Elektronik.</li> <li>▪ Hocheffiziente Laser-Resonatoren aus nanoskaligen Vielschichtstrukturen, Änderung der Bauelementeeigenschaften anhand von nanoskaligen aktiven Zonen (quantum wells, quantum wires und quantum dots)Komplexere Laserstrukturen: ultraschnelle Laser, abstimmbare Laser, Chirped-DFB-Gitter, Mikroscheibenlaser, Quantum Cascade Laser, DBR-Spiegel für vertikale Kavitätslaser, VCSELS, blaue Halbleiterlaser. Beim Quantum Cascade Laser wird detailliert in den Aufbau und die Wirkungsweise der nanoskaligen Halbleiter-Vielfach-Heterostruktur eingeführt. Folgende nanoskalige Komponenten werden detailliert verdeutlicht: DBR-Resonator-Spiegel im VCSEL, Wellenleiter im Kantenemitter, nanoskalige aktive Materialien (quantum wells, quantum wires und quantum dots) in allen Lasern.</li> <li>▪ Lichtverarbeitung: Schalter, Modulator, Splitter, Verstärker, Combiner, Multiplexer, Demultiplexer, Strahltransformer.</li> <li>▪ Einführung in die Analytik in der Nanotechnologie und Darstellung der besonderen Bedeutung bei der Erfassung geometrischer und kompositioneller Parameter mit sehr hoher Präzision während des technologischen Prozesses und nach Fertigstellung der Komponenten. Strukturierungs- und Depositionsgenauigkeiten <math>&lt;1\text{nm}</math> müssen messtechnisch erfasst werden, da fast alle Di-</li> </ul>
--	--

	<p>mensionen der Bauelemente einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Bauelemente-Eigenschaften haben. Die Nanotechnologie ist bezüglich Struktur, Prozess und Monitoring allgegenwärtig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interferometrie, Weisslichtinterferometrie, integrierte Interferometer, Faser-Bragg-Gitter basierte Sensoren</li> <li>▪ Vermessung von Dünnschichten (Ellipsometrie)</li> <li>▪ Beugung von Röntgenstrahlen, Elektronen (XRD; RHEED)</li> <li>▪ Absorptions- und Transmissions-Spektroskopie</li> <li>▪ Gassensorik, (Intra-Cavity-Absorption-Spectroscopy)</li> <li>▪ Rastersondenmikroskopie, Cantileverbasierte Sensorik, Rasterelektronenmikroskopie. Hierbei werden die erzielbaren Auflösungsgenauigkeiten im sub nm Bereich adressiert. Zahlreiche Beispiele aus der nanotechnologischen Analytik werden gezeigt.</li> <li>▪ Apparative Aufbauten für Photolumineszenz Untersuchungen, Entstehung von Photolumineszenz in anorganischen und organischen Materialien. Detailliert wird darauf eingegangen, eine Vielzahl von unterschiedlichen Quantenfilmdicken quantitativ mit sub nm Genauigkeit aus dem Photolumineszenz-Spektrum zu extrahieren.</li> <li>▪ Messungen von Ladungsträgertransport in Halbleitermaterialien mit Hilfe optischer Flugzeit-Spektroskopie mit sehr hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung, nanoskalige Strukturierung liefert das geometrische Gerüst der Methode, Gain-Messung</li> <li>▪ Magneto-resistive Effekte (GMR, AMR)</li> </ul>
Literatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J.Gowar, <i>Optical Communication Systems</i>, 2<sup>nd</sup> Ed., Prentice Hall, 1993.</li> <li>▪ K.Iga, S.Kinoshita, <i>Process technology for semiconductor lasers</i>, Springer, Series in Material Science 30, 1996.</li> <li>▪ S.L.Chuang, <i>Physics of Optoelectronic Devices</i>, John Wiley &amp; Sons, New York, 1995.</li> <li>▪ B.Mroziewicz, M.Bugajski and W.Nakwaski, <i>Physics of semiconductor lasers</i>, North-Holland, Amsterdam, 1991.</li> <li>▪ G.P. Agrawal, N.K. Dutta, <i>Long-wavelength semiconductor lasers</i>, Van Nostrand, 1986.</li> <li>▪ L.A. Coldren &amp; S.W. Corzine, <i>Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits</i>, John Wiley, New York, 1995.</li> <li>▪ M. Young, <i>Optics and lasers</i>, Springer-Verlag, Heidelberg, 1993.</li> <li>▪ P. Bhattacharya, <i>Semiconductor Optoelectronic Devices</i>, 2nd edition, Prentice Hall, London, 1997.</li> <li>▪ F. Träger (Editor), <i>Springer Handbook of Lasers and Optics</i>, Springer, 2011.</li> <li>▪ O. Solgaard, <i>Photonic Microsystems</i>, Springer Science + Business Media 2009.</li> <li>▪ W. Göpel, <i>Sensors – A Comprehensive Survey</i>, VCH, 1997.</li> <li>▪ P. Török, <i>Optical Imaging and Microscopy</i>, Springer, 2007.</li> <li>▪ Bhushan (Ed.), <i>Springer Handbook of Nanotechnology</i>, 2nd. Ed., Springer, 2007</li> <li>▪ D.B. Murphy, <i>Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging</i>, John Wiley &amp; Sons, 2001</li> </ul>

<b>Medienformen</b>	Beamer (Vorlesungspräsentation), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Verwendung von softwaretechnischen interaktiven Visualisierungstools, die die Studierenden im hands-on Betrieb erfahren, Papier (Übungen).
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbau und Wirkungsweise optoelektronischer Bauelemente nachvollziehen.</li> <li>• das Designpotential der Nanotechnologie, das Maßschneiden von Material- und Bauelemente-Eigenschaften durch das Maßschneiden nanoskaliger Geometrieparameter statt Legierungsvariationen der Materialien erfassen und anwenden. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die grundlegenden Prinzipien nanophotonischer Bauteile und Systeme sowie Struktur und Einsatzgrundsätze nanophotonischer Komponenten nachvollziehen.</li> </ul> </li> <li>• die Ähnlichkeit der Quantisierung (Eigenwerte, Eigenfunktionen) in elektronischen und photonischen Systemen erfassen, d.h. immer dann wenn die korrespondierenden Differentialgleichungen im Ortsraum mathematisch gleiche Struktur und Ordnung aufweisen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ das Anwendungspotenzial nanophotonischer Bauteile und photonischer Werkzeuge nachvollziehen und eigenständig aufarbeiten.</li> <li>▪ das komplexe Zusammenspiel der elektronischen, thermischen und optischen Phänomene in Laserdioden ermesen.</li> <li>▪ die physikalischen Gesetzmäßigkeiten von grundlegenden Messmethoden der Analytik in der Nanotechnologie nachvollziehen.</li> <li>▪ die verschiedenen bildgebenden Messverfahren überblicken.</li> </ul> </li> <li>• Methodik entwickeln, um selbständig Wissen von einem Gebiet auf das andere zu übertragen.</li> <li>• Naturphänomene als Lösungsansätze erkennen und eigenständig daraus weitergehende Lösungen entwickeln.</li> <li>• Problemlösungen durch interdisziplinäre Analogien erarbeiten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selbständig in Forschung und Entwicklung im Bereich nanophotonischer Bauelemente arbeiten und dabei die erworbenen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ – experimentellem und theoretischem Kenntnisse nanophotonischer Bauelemente,</li> <li>○ – nachhaltigen Kenntnisse des Entwurfs, des Betriebs und des Einsatzes nanophotonischer Bauelemente</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>anwenden.</p>

Modultitel	Software Components for Communication Systems R2				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Introduction to Information Theory and Coding (lec)	Vorlesung	3	4	30-minütige mündliche Prüfung
	Introduction to Information Theory and Coding (ex)	Übung	1	1	
	Introduction to Functional Safety (lec)	Vorlesung	2	3	30-minütige mündliche Prüfung
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	8				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Sommersemester, jährlich				
<b>Dozent</b>	Dahlhaus/Börcsök und Mitarbeiter				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Dahlhaus				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagenkenntnisse der digitalen Kommunikation</li> <li>▪ Grundlagenkenntnisse der Rechnerarchitektur</li> </ul>				
<b>Arbeitsaufwand</b>	90 Stunden Präsenzzeit 150 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einführung in Signalverarbeitungsverfahren der physikalischen Schicht und Medienzugriffsschicht des OSI-Modells in drahtlosen Kommunikationssystemen mit mikro- und nanoskaligen Komponenten</li> <li>▪ Grundlagen der Informationstheorie, Kanalcodierung, Blockcodes, lineare und zyklische Codes, systematische Form, Syndromdecodierung, Soft Decision und Hard Decision, Faltungscodes, Trellisdiagramme, Zustandsgleichung und Übertragungsfunktion, Viterbialgorithmus, Quellencodierung für diskrete gedächtnisfreie Quellen, Lempel-Ziv-Algorithmus, Rate-Distortion-Function, Codierung analoger Quellen, zeitliche/spektrale Signalformcodierung, Pulse-Code-Modulation (PCM), Compandor, differentielle PCM (DPCM), adaptive PCM (APCM), Delta-Modulation, modellbasierte Codierung, Linear Predictive Coding (LPC)</li> <li>▪ Grundlagen der funktionale Sicherheit, Fehler, Fehlerarten, Common-Cause Fehler, Risikobestimmung, Architekturen, Strukturen, Funktionsblockanalysen, Markov-Modelle, Fehlerbaumanalyse, Berechnungsmethoden, Proof-Test</li> </ul>				
<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ T. Cover and J.A. Thomas, <i>Elements of Information Theory</i>, 2nd ed., Wiley, ISBN: 978-0-471-24195-9</li> <li>▪ J.G. Proakis, <i>Digital Communications</i>, McGraw-Hill, 4th ed., ISBN 0-07-118183-0.</li> <li>▪ Papoulis, S. U. Pillai, <i>Probability, Random Variables, and Stochastic Processes</i>,</li> </ul>				

	<p>McGraw-Hill, 4th ed., ISBN 0071226613.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J. Börcsök, Functional Safety, Huethig 2007, ISBN 987-3-7785-2986-7</li> <li>▪ A. Birolini, Reliability Engineering, Springer 5th ed., 2007, ISBN 978-3-540-49388-4</li> </ul>
<b>Medienformen</b>	Beamer (Vorlesungspräsentation, Seminarvortrag), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen).
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Signalverarbeitungsverfahren in der physikalischen Schicht und Medienzugriffsschicht des OSI-Modells in drahtlosen Kommunikationssystemen mit mikro- und nanoskaligen Komponenten verstehen und wiedergeben.</li> <li>▪ Quellen- und Kanalcodierung als Grundlage digitaler Übertragungssysteme erfassen und informationstheoretische Prinzipien in Übertragungssystemen Literatur- und Internetrecherche im Rahmen eines Themas der Informationstheorie und Codierung anwenden.</li> <li>▪ die Funktionsweise von Sicherheitssystemen und deren Modellierung und Berechnung nachvollziehen, Systeme der funktionalen Sicherheit analysieren und modellieren und die Sicherheitsintegrität unterschiedlicher Systemarchitekturen nachweisen.</li> <li>▪ im Bereich der drahtlosen Kommunikationssysteme mit mikro- und nanoskaligen Komponenten, der Informationstheorie und Codierung forschen und entwickeln.</li> <li>▪ im Bereich sicherer Entwurf von Hardware- und Softwarekomponenten in Systemen mit funktionaler Tätigkeit forschen und entwickeln.</li> <li>▪ im Bereich mikro- und nanoskaliger Kommunikationstechnologie beraten.</li> <li>▪ nachhaltiges Wissen über die Modellierung, Analyse und Berechnungsmöglichkeiten bei Systemen mit funktionaler Sicherheit anwenden.</li> <li>▪ Qualitätsmerkmale in Systemen mit funktionaler Sicherheit beurteilen.</li> </ul>

Modultitel	Computational Design of Photonic Devices R3				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Fields and Waves in Optoelectronic Devices (lec)	Vorlesung	2	3	30-minütige mündliche Prüfung
	Fields and Waves in Optoelectronic Devices (ex)	Übung	1	1	
Credits für das Gesamtmodul	4				
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Wintersemester, jährlich				
Dozent	Witzigmann/ und Mitarbeiter				
Verantwortliche(r)	Witzigmann				
Teilnahmevoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagenkenntnisse der Elektromagnetik</li> <li>▪ Kenntnisse der Inhalte der Lehrveranstaltung "Electromagnetic Field Theory 1" bzw. vergleichbare Kenntnisse und Fertigkeiten</li> </ul>				
Arbeitsaufwand	45 Stunden Präsenzzeit 75 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagen der Strahlen- Wellenoptik</li> <li>▪ Grundlagen der Quantenmechanik, Anwendung in elektronischen Nanostrukturen</li> <li>▪ Felder und Wellen in optoelektronischen Bauelementen</li> <li>▪ Nanophotonik und deren theoretische Beschreibung</li> <li>▪ Aufbau und Verständnis der Funktionsweise moderner optischer Bauelemente (Laser, VCSEL, Photodioden, Nanokavitäten)</li> </ul>				
Literatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S.L. Chuang, Physics of optoelectronic Devices, Wiley</li> <li>▪ Coldren, Corzine, Integrated Optoelectronics</li> <li>▪ Saleh, Teich, Optics</li> <li>▪ Fachliteratur gemäß Seminarthemen.</li> </ul>				
Medienformen	Beamer (Vorlesungspräsentation, Seminarvortrag), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen).				
Angestrebte Lernergebnisse	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Funktionalität von Halbleiter-Nanostrukturen in optoelektronischen Bauelementen verstehen.</li> <li>▪ elektromagnetische Prinzipien, angewandt auf die Charakteristik in Halbleiter-Bauelementen nachvollziehen.</li> <li>▪ Halbleiter-Resonatoren und -Wellenleiter für Laser, LEDs oder Photodioden selbständig entwerfen.</li> <li>▪ im Rahmen eines Themas der Optoelektronik und Nanophotonik die erforderli-</li> </ul>				

	<p>che Literatur- und Internetrecherche eigenständig durchführen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ein Thema im Bereich des Bauelementdesigns und der Funktionsanalyse selbstständig wissenschaftlich erarbeiten und über das Thema referieren.</li><li>▪ komplexe Simulationssoftware für Elektromagnetik und Nanophotonik anwenden.</li><li>▪ im Bereich des optoelektronischen Bauelemententwurfs und im Bereich der Bauelemente für Kommunikation, Sensorik und Photovoltaik unter Einbeziehung von Nanostrukturen forschen und entwickeln, sowie im Bereich der Informationstechnologie beraten.</li></ul>
--	--

Modultitel	Nanosystem Technology, Fabrication Aspects R4				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Micro- and nanosystem technology (lec)	Vorlesung	2	3	30-minütige mündliche Prüfung
	Micro- and nanosystem technology (ex)	Übung	1	1	
	Technology of electronic and optoelectronic devices (lec)	Vorlesung	2	3	
	Technology of electronic and optoelectronic devices (ex)	Übung	1	1	
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	8				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Sommersemester				
<b>Dozent</b>	Hillmer und Mitarbeiter				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Hilmer				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	Grundlagenkenntnisse der Halbleiterbauteile (Transistor, Laserdiode, LED, Photodiode), Materialwissenschaften und Optik				
<b>Arbeitsaufwand</b>	90 Stunden Präsenzzeit 180 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einführung in moderne Fabrikationsprozesse der Nanotechnologie. Diese umfasst im Einzelnen Fasertechnologie, Dünnschichtdeposition und die Herstellung von Wellenleitern, Lasern, Transistoren, ICs und mikromechanischen Komponenten. Verdeutlichung, dass alle diese modernen Bauelemente mindestens eine nanoskalige optische oder elektronische Teilfunktion aufweisen.</li> <li>▪ Kristallwachstum: Halbleiter-Einkristalle, Halbleiter-Wafer, Dünnschichtepitaxie</li> <li>▪ Herstellung von Glas und Reinst-Silizium aus Sand, Wafer-Herstellung (Orientierung, Sägen, Polieren, Orientierungskennung)</li> <li>▪ Lithographie: optische Lith., Röntgen-Lith., Elektronenstrahl-Lith., Ionenstrahl-Lith., EUVL, Nanoimprint Lith.</li> <li>▪ Fokussierung auf die fortschreitende Verbesserung der Auflösung, um zu immer kleineren Dimensionen im nm Bereich vorzustoßen. In allen Fällen werden die jeweiligen Auflösungslimits detailliert erläutert. Im Fall der Nanoimprint Technologie werden die Limits vertikaler und lateraler Miniaturisierungsgrenzen detailliert behandelt und dem aktuellen Stand der Technik gegenübergestellt.</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verallgemeinerung: Allgemeine Limits der Miniaturisierung vor dem Hintergrund der de Broglie Wellenlänge, der Oxidfunktionalität, der Wärmeableitung, der Strukturgröße einzelner Festkörperatome und der Molekülgrößen</li> <li>▪ Plasmaprozesse und Vakuumtechnologie</li> <li>▪ Depositionstechniken Aufdampfen, Sputtern, Plasma unterstützte Technologien</li> <li>▪ Trocken- und Nasschemisches Ätzen</li> <li>▪ Bei allen diesen aufgeführten technologischen Prozessen wird stets besonderer Wert auf die Strukturierungs- und Depositionsgenauigkeit gelegt, welche bis &lt;1nm betragen kann. Korrespondierendes Monitoring und Prozesskontrolle. Verdeutlichung der Einhaltung der nanoskaligen Strukturierungspräzision.</li> <li>▪ Reinräume: Zweck, gebäudetechnische Konstruktion, allgemeiner Betriebsablauf, Verhalten und Arbeiten im Reinraum</li> <li>▪ Fabrikationstechnologie von nanoelektronischen Bauelementen (Planartransistor, elektronische Integration), nanophotonischen Komponenten und Bauelementen (Halbleiterlaser, Gitterstrukturen) und mikro-opto-elektromechanischen Systemen (MOEMS) bzw. nano-opto-elektromechanischen Systemen (NOEMS)</li> <li>▪ Einführung in die Mikromechanik, Mikro- und Nanosystemtechnik, Miniaturisierung, Packaging und Nanotechnologie</li> <li>▪ Gründe für Miniaturisierung und Integration, verschiedene Arten der Mikro- und Nanomechanik und Integration.</li> <li>▪ Sensoren und Aktuatoren</li> <li>▪ Beispiele für NEMS, MEMS, MOEMS und NOEMS: Membrane, Federn, Resonatoren, Träger, Ausrichtungswerkzeuge, mechanische Ventile, Bedienelemente optischer Komponenten, Haltewerkzeuge, Lichtmodulatoren, Schalter, Strahlteiler, Projektionsanzeigen, Mikrooptischer Tisch, Datenverteilung, mikromechanisch abstimmbare Filter und Laser</li> <li>▪ Displays: mikromechanische (mikrospiegelnde) Displays, Lasertechnologie, Vakuumelektronik</li> </ul>
Literatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R. Williams, <i>Modern GaAs Processing Methods</i>, Artech House, Inc., ISBN 0-89006-343-5, 1990.</li> <li>▪ W. Menz, J.Mohr and O. Paul, <i>Microsystem Technology</i>, VCH-Verlag, 2001.</li> <li>▪ H.I. Smith, <i>Submicron- and nanometer-structures technology</i>, 2nd edition, NanoStructures Press, 437 Peakham Road, Sudbury, MA 01776, USA, 1994.</li> <li>▪ D.V. Morgand and K. Board, <i>An introduction to semiconductor microtechnology</i>, 2<sup>nd</sup> edition, John Wiley &amp; Sons, Chichester 1994</li> <li>▪ K. Iga, S. Kinoshita, <i>Process technology for semiconductor lasers</i>, Springer, Series in Material Science 30, 1996.</li> <li>▪ G.P. Agrawal, N.K. Dutta, <i>Long-wavelength semiconductor lasers</i>, Van Nostrand, 1986.</li> <li>▪ M. Young, <i>Optics and lasers</i>, Springer-Verlag, Heidelberg, 1993.</li> <li>▪ P. Bhattacharya, <i>Semiconductor Optoelectronic Devices</i>, 2nd edition, Prentice Hall, London 1997.</li> <li>▪ T.E. Sale, <i>Vertical cavity surface emitting lasers</i>, John Wiley &amp; Sons Inc., New York, 1995.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B. Bhushan (Editor), <i>Springer Handbook of Nanotechnology</i>, Springer, 2004.</li> </ul>
<b>Medienformen</b>	Beamer (Vorlesungspräsentation), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen).
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagen der nanotechnologischen Fabrikationstechniken, der Mikro- und Nanomechanik, MEMS, NEMS, MOEMS und NOEMS nachvollziehen und differenzieren.</li> <li>▪ Grundlagen der nanoskaligen Halbleitertechnologie inklusive spezifischer Prozesse, Verfahren und erforderlichen Maschinen erfassen.</li> <li>▪ die Methodik, interdisziplinären Aspekte, zukünftige Perspektiven und Marktentwicklungen nachvollziehen.</li> <li>▪ Problemlösungen, u.a. durch Anwendung interdisziplinärer Ansätze erarbeiten.</li> <li>▪ Synergien zwischen Ingenieur- und Naturwissenschaften herstellen.</li> <li>▪ die erworbenen Kenntnisse der Nanotechnologie, Mikromechanik, Bauteile, Dünnschicht- und Reinraumtechnologie im praktischen Einsatz (Reinraum) anwenden.</li> <li>▪ Methodiken in speziellen Miniaturisierungsverfahren und Integration elektronischer und optoelektronischer Bauteile und Systeme selbständig nachvollziehen und erweitern und dabei nachhaltiges Wissen des Entwurfs, der Herstellung und des Einsatzes nanoelektronischer, (opto)elektronischer und nano- bzw. mikromechanischer Bauteile anwenden.</li> </ul>

Modultitel	Optical Communication Systems and ONTE Seminar R5				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Nanophotonic and optoelectronic Student Seminar (sem)	Seminar	2	3	2x 30-minütiger Vortrag
	Optical Communication Systems (lec)	Vorlesung	2	3	15-minütige mündliche Prüfung
Credits für das Gesamtmodul	6				
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Sommersemester				
Dozent(en)	Bangert, Börcsök, Dahlhaus, Hillmer, Witzigmann				
Verantwortliche(r)	Bangert				
Teilnahmevoraussetzungen	Grundlagenwissen der Nanotechnologie, der Halbleiterelektronik, Grundlagen der Materialkunde, der digitalen Kommunikation, der optischen Kommunikationssysteme, der Nanosystemtechnologie und Nanosensorik sowie der Rechnerarchitektur				
Arbeitsaufwand	60 Stunden Präsenzzeit 120 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spezielle Themen der Nanophotonik und Optoelektronik (Seminar).</li> <li>▪ Grundlagen der faseroptischen Übertragung</li> <li>▪ Fibre-To-The-X-Technologien</li> <li>▪ WDM</li> <li>▪ Photonische Netzwerke</li> <li>▪ SONET-Standard</li> <li>▪ Systemaspekte</li> <li>▪ Einsatz nanophotonischer Komponenten in Sendern, Empfängern und Netzwerken</li> <li>▪ Nanostrukturierte elektronische Hochgeschwindigkeits-Systemkomponenten in optischen Kommunikationssystemen</li> <li>▪ Digitale Übertragung in photonischen Kommunikationssystemen</li> </ul>				
Literatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J.Gowar, <i>Optical Communication Systems</i>, 2<sup>nd</sup> Ed., Prentice Hall, 1993.</li> <li>▪ J.G. Proakis, <i>Digital Communications</i>, McGraw-Hill, 4. Aufl., ISBN 0-07-118183-0.</li> <li>▪ S.L.Chuang, <i>Physics of Optoelectronic Devices</i>, John Wiley &amp; Sons, New York, 1995.</li> <li>▪ G.P. Agrawal, <i>Fiber-Optic Communication Systems</i>, John Wiley &amp; Sons, New</li> </ul>				

	<p>York, 1997.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J.P.Laude, <i>DWDM: Fundamentals, Components and Applications</i>, Artech House, 2002.</li> <li>▪ J. Börcsök, <i>Functional Safety –Basic Principles of Safety-related Systems</i>, Hüthig-Verlag Heidelberg, ISBN 978-3-7785-2986-7 (2007).</li> </ul>
<b>Medienformen</b>	Beamer (Vorlesung, Seminarvortrag), Tafel, Test- und Finalpräsentation (Einführung in Vortragstechniken), Körpersprache (Mimik, Gestik).
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• das Zusammenwirken von nanophotonischen Bauelementen und Komponenten in Systemen, sowie das Designpotential der Nanotechnologie, das Maßschneiden von Material und Bauelemente-Eigenschaften durch das Maßschneiden nanoskaliger Geometrieparameter statt Legierungsvariation der Materialien nachvollziehen.</li> <li>• grundlegende Prinzipien nanophotonischer Bauteile und System sowie Struktur und Einsatzgrundsätze nanophotonischer Komponenten erfassen und das Anwendungspotenzial nanophotonischer Bauteile und photonischer Werkzeuge nachvollziehen.</li> <li>• Messdaten analysieren und den Vergleich experimenteller und theoretischer Ergebnisse und Schlussweisen erarbeiten.</li> <li>• unterschiedliche Aufbauten zur optischen Charakterisierung effizient anwenden.</li> <li>• Entwurfsstrategien für optische Kommunikationssysteme ausarbeiten.</li> <li>• die Anforderungen und Entwurfsgrundsätze für elektrooptische und optoelektrische Schnittstellen zuordnen und anwenden.</li> <li>• Problemlösungen, u.a. durch Anwendung interdisziplinärer Analogien finden und dabei auf das Verständnis von Naturphänomenen als Lösungsansätze zurückgreifen.</li> <li>• mittels vertiefter Präsentationstechniken (Gliederung, roter Faden, Strukturierung, Gestik, Mimik, Sprache, Spannungsbögen, präzises Einhalten von Zeitvorgaben) zwei umfangreiche und wissenschaftlich anspruchsvolle Vorträge optimiert aufbauen.</li> <li>• ein für die Studierenden neues Thema selbständig erarbeiten.</li> <li>• die Einsatzmöglichkeiten nanophotonischer Komponenten in Systemen beurteilen</li> <li>• nanotechnologische Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf zukünftige Kommunikationssysteme abschätzen.</li> </ul>

## Module Practical Training

Modultitel	Nanophotonic Devices and Components P1				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
		Practical Training I (Micromachined filter measurement)	Praktikum	2	3
	Practical Training II (Semiconductor laser measurement)	Praktikum	2	3	Bericht und Vortrag
Credits für das Gesamtmodul	6				
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Sommer- oder Wintersemester, Themen jederzeit auf Anfrage				
Dozent	Hillmer und Mitarbeiter				
Verantwortliche(r)	Hillmer				
Teilnahmevoraussetzungen	Vertiefte Kenntnisse der Optoelektronik				
Arbeitsaufwand	60 Stunden Präsenzzeit 120 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konfokale Spektroskopie an nanophotonischen Filterarrays</li> <li>▪ Faseroptische Reflexions- und Transmissions-Spektroskopie</li> <li>▪ Messung von nanokavitätsinduzierten Strukturen und nanophotonischen Filterbauelementen</li> <li>▪ Vergleich der experimentellen Messungen mit den Ergebnissen theoretischer Modellrechnungen</li> <li>▪ Messung von statischen und mikromechanisch abstimmbaren Sensorarrays, welche mit Nanoimprint hergestellt wurden</li> <li>▪ Messung von modernen nanophotonischen DFB Halbleiterlasern, welche für ultrahohe Modulationsbandbreiten in der faseroptischen Telekommunikationstechnik hergestellt wurden, Variation von grundlegenden Halbleiterlaserparametern (Injektionsstrom, Temperatur), Messung der Variation der Bragg- und Seitenmodenwellenlängen als Funktion des Injektionsstroms und der Temperatur</li> <li>▪ Interpretation der Ergebnisse</li> <li>▪ Das praktische Training wird ständig aktualisiert und an aktuelle Probleme der Nanophotonik angepasst.</li> </ul>				
Literatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M. Young, Optics and lasers, Springer-Verlag, Heidelberg, 1993.</li> <li>▪ J.M. Vaughan, <i>The Fabry Pérot interferometer</i>, Hilger, 1989</li> <li>▪ H. Ghafouri-Shiraz, <i>The principles of semiconductor laser diodes and amplifi-</i></li> </ul>				

	<p>ers, Imperial College Press, London, 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W.W. Chow, S.W. Koch, <i>Semiconductor laser fundamentals</i>, Springer-Verlag, Berlin, 1999</li> </ul> <p>Fachliteratur gemäß Projektthema.</p>
<b>Medienformen</b>	Training an Labor-Messplätzen, Beamer (Abschlusspräsentation), Bericht (elektronisch und Papier).
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die experimentelle Charakterisierung von nanophotonischen Bauelementen eigenständig planen, durchführen und dokumentieren.</li> <li>▪ das grundsätzliche Zusammenspiel von Effekten durch Variation geometrischer Parameter, Materialien, Temperatur und Injektionsstrom nachvollziehen.</li> <li>▪ leistungsfähige photonische Bauelemente durch die Kombination praktischer Erfahrung und Vorlesungsinhalte differenzieren.</li> <li>▪ in wissenschaftlicher Form experimentelle Ergebnisse durch Analyse und Interpretation mit spezifischen Bauelementeeigenschaften korrelieren.</li> <li>▪ die Analyse von Daten- und Parameterfolgen verständlich strukturieren und vor einem Auditorium mit Grundkenntnissen im jeweiligen Themenbereich präsentieren.</li> <li>▪ die erforderlichen experimentellen Charakterisierungen eigenständig organisieren und ein entsprechendes Projektmanagement, sowohl für den einzelnen wie auch für ein Team (Gruppenarbeit) nachweisen.</li> </ul>

<b>Modultitel</b>	<b>Clean Room Technologies P2</b>				
<b>Lehrveranstaltungen</b>	<b>Titel</b>	<b>Form</b>	<b>SWS</b>	<b>Credits</b>	<b>Studien-/ Prüfungsleistung</b>
	Practical Training III (Clean Room)	Praktikum	4	5	Bericht und Vortrag
	Practical Training IV (Clean Room)	Praktikum	4	5	Bericht und Vortrag
	Practical Training V (Clean Room)	Praktikum	4	5	Bericht und Vortrag
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	15				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Sommer- oder Wintersemester, Themen jederzeit auf Anfrage				
<b>Dozent</b>	Hillmer und Mitarbeiter				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Hillmer				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	Vertiefte Kenntnisse der Optoelektronik				
<b>Arbeitsaufwand</b>	180 Stunden Präsenzzeit 270 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optische Lithographie und Analytik</li> <li>▪ Nanoimprint Lithographie und Analytik</li> <li>▪ Optische Mikroskopie an Mikrostrukturen</li> <li>▪ Rasterelektronenmikroskopie an Nanostrukturen</li> <li>▪ Ionenmikroskopie an Nanostrukturen</li> <li>▪ Weisslichtinterferometrie an Mikro- und Nanostrukturen</li> <li>▪ Prozessmonitoring von nano- und mikro- skaligen Strukturen</li> <li>▪ Vergleich von experimentellen Messungen mit den Ergebnissen theoretischer Modellrechnungen</li> <li>▪ Variation von grundlegenden nanoskaligen, geometrischen Parametern der Bauelemente und Komponenten und nachfolgende Interpretation der Ergebnisse</li> <li>▪ Folgende vier nanotechnologischen Standardverfahren werden im Praktikum von den Studierenden durchgeführt, wobei nanotechnologische Teststrukturen und einfache nanophotonische Komponenten hergestellt werden <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Depositionstechnologien (Aufdampfen, Sputtern, Aufschleudern, plasma-assistierte Technologien)</li> <li>○ Lift-off Technik</li> <li>○ Plasmaätzttechnologien</li> <li>○ Nasschemisches Ätzen, Opferschichttechnologien in der Mikro- und Nanosystemtechnik</li> </ul> </li> <li>▪ Verdeutlichung, dass die Analytik in der Nanotechnologie eine besondere Rolle</li> </ul>				

	<p>spielt, dass geometrische und kompositionelle Parameter mit sehr hoher Präzision während des technologischen Prozesses und nach Fertigstellung der Komponenten von essentieller Bedeutung sind. Strukturierungs- und Depositionsgenauigkeiten &lt;1nm müssen messtechnisch erfasst werden, da fast alle Dimensionen der Bauelemente einen ganz wesentlichen Einfluss auf die finalen Bauelemente-Eigenschaften haben. Das praktische Training wird ständig aktualisiert und an aktuelle Probleme der Nanophotonik angepasst.</p>
<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B. Bhushan (Editor), <i>Springer Handbook of Nanotechnology</i>, Springer, 2004</li> <li>▪ W. Menz, J. Mohr and O. Paul, <i>Microsystem Technology</i>, VCH Verlag, 2001</li> <li>▪ H.I. Smith, <i>Submicron- and nanometer-structures technology</i>, 2nd edition, Nano Structures Pres, 437 Peakham Road, Sudbury, MA 01776, USA, 1994.</li> <li>▪ R.J. Shul, <i>Handbook of advanced plasma processing techniques</i>, Springer-Verlag, Berlin, 2000.</li> <li>▪ M.A. Herman, H. Sitter, <i>Molecular Beam Epitaxy</i>, Springer-Verlag, 1996</li> <li>▪ S.M. Rossnagel, <i>Handbook of pasma processing technology</i>, Noyes, 1990</li> </ul> <p>Fachliteratur gemäß Projektthema.</p>
<b>Medienformen</b>	<p>Training im Reinraumlabor, Beamer (Abschlusspräsentation), Bericht (elektronisch und Papier).</p>
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verschiedene Lithographie-, Depositions- und Ätztechnologien eigenständig anwenden.</li> <li>▪ das grundsätzliche Zusammenspiel der verschiedenen Prozesse unter Berücksichtigung der Parameter wie z.B. Materialien, Temperatur und Leistung nachvollziehen.</li> <li>▪ nanophotonische Strukturen experimentell analysieren und nanophotonische Bauelemente charakterisieren.</li> <li>▪ leistungsfähige photonische Bauelemente durch die Kombination praktischer Erfahrung und Vorlesungsinhalte differenzieren.</li> <li>▪ in wissenschaftlicher Form experimentelle Ergebnisse durch Analyse und Interpretation mit spezifischen Bauelementeeigenschaften korrelieren.</li> <li>▪ die Analyse von Daten- und Parameterfolgen verständlich strukturieren und vor einem Auditorium mit Grundkenntnissen im jeweiligen Themenbereich präsentieren.</li> <li>▪ die erforderlichen experimentellen Charakterisierungen eigenständig organisieren und ein entsprechendes Projektmanagement, sowohl für den einzelnen wie auch für ein Team (Gruppenarbeit) nachweisen.</li> </ul>

## Thesenmodule

Modultitel	Optoelectronics T1				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Master Thesis in Optoelectronics	Abschlussarbeit (Master Thesis)	20	30	Bericht und Vortrag
Credits für das Gesamtmodul	30				
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Sommer- oder Wintersemester, Themen jederzeit auf Anfrage				
Dozent	Hillmer				
Verantwortliche(r)	Hilmer				
Teilnahmevoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagenkenntnisse der Optoelektronik</li> <li>▪ Nachweis der Zulassungsvoraussetzung zur Master Thesis gemäß ONTE-Prüfungsordnung.</li> </ul>				
Arbeitsaufwand	300 Stunden Präsenzzeit 600 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selbstständige wissenschaftliche Behandlung einer Fragestellung aus dem Bereich der Photonik und verwandter Themen wie Entwurfsverfahren, technologische Herstellungsverfahren im Reinraum, Charakterisierung von optoelektronischen Bauteilen oder Systemen, Nanotechnologie und Mikromechanik</li> <li>▪ Die Studierenden behandeln Probleme mit großem Anwendungspotenzial, zum Teil in Konsortien mit Industriebeteiligung.</li> </ul>				
Literatur	Fachliteratur gemäß Thema der Arbeit.				
Medienformen	Softwareentwicklung am Rechner und/oder Hardwareentwicklung, Messinstrumente und Experimente, Beamer (Präsentation der Ergebnisse), Bericht (elektronisch und Papier).				
Angestrebte Lernergebnisse	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ theoretische Modelle für ein bestimmtes Problem herleiten.</li> <li>▪ experimentelle Arbeiten im Bereich der Nanotechnologie oder der Charakterisierung von nanophotonischen Bauelementen eigenständig durchführen oder selbständig theoretische Modelle entwerfen und für Simulationsrechnungen nutzen.</li> <li>▪ Messdaten in wissenschaftlicher Form analysieren und interpretieren.</li> <li>▪ die eigenen Ergebnisse mit Ergebnissen aus der Literatur vergleichen und einordnen</li> <li>▪ einen wissenschaftlichen Bericht und einen Vortrag der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums selbständig erstellen und in wissenschaftlicher Form prä-</li> </ul>				

	<p>sentieren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Arbeiten in Gruppen/Projekten effizient managen.</li><li>▪ Verdeutlichen, dass Modellbildung, Design, Prozess- und Herstellungstechnik sowie Analytik in der Nanotechnologie eine besondere Rolle spielt, dass geometrische und kompositionelle Parameter mit sehr hoher Präzision während des technologischen Prozesses und nach Fertigstellung der Komponenten von essentieller Bedeutung ist. Strukturierungs- und Depositionsgenauigkeiten &lt;1nm müssen prozesstechnisch beherrschbar und messtechnisch erfasst werden, da fast alle Dimensionen der Bauelemente einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Bauelemente-Eigenschaften haben. Die Nanotechnologie ist bezüglich Struktur, Prozess und Monitoring allgegenwärtig.</li></ul>
--	---

<b>Modultitel</b>	<b>Electromagnetic Nanoscience T2</b>				
<b>Lehrveranstaltungen</b>	<b>Titel</b>	<b>Form</b>	<b>SWS</b>	<b>Credits</b>	<b>Studien-/ Prüfungsleistung</b>
	Master Thesis in Electromagnetic Nanoscience	Abschlussarbeit (Master Thesis)	20	30	Bericht und Vortrag
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	30				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Sommer- oder Wintersemester, Themen jederzeit auf Anfrage				
<b>Dozent</b>	Witzigmann und Mitarbeiter				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Witzigmann				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagenkenntnisse der theoretischen Elektrotechnik</li> <li>▪ Nachweis der Zulassungsvoraussetzung zur Master Thesis gemäß ONTE-Prüfungsordnung.</li> </ul>				
<b>Arbeitsaufwand</b>	300 Stunden Präsenzzeit 600 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Theoretische Probleme der Elektromagnetik in nanophotonischen Bauelementen, Komponenten und Systemem, welche einen deutlichen Anwendungsbezug aufweisen</li> <li>▪ 2- und 3-dimensionale Simulation und Design nanophotonischer Bauelemente:LED, Laser, Solarzellen, Resonatoren, Wellenleiter</li> <li>▪ Anwendung nanophotonischer Systeme in der Optik</li> <li>▪ Entwerfen und Anwenden numerischer Methoden der elektromagnetischen Nanostrukturwissenschaften für die Anwendungen im optischen und nahen IR Spektralbereich</li> <li>▪ Methodenentwicklung für theoretische Modellrechnungen auf dem Gebiet der Nanophotonik</li> <li>▪ Nanoskalige physikalische Modellbildung unter Berücksichtigung quantenmechanischer Einflüsse in der Nanophotonik und Nanoelektronik</li> </ul>				
<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S.L. Chuang, Physics of Optoelectronic Devices,</li> <li>▪ J. Jin, The Finite Element Method in Electromagnetics, John Wiley &amp; Sons, 2002.</li> <li>▪ Fachliteratur gemäß Thema der Arbeit.</li> </ul>				
<b>Medienformen</b>	Softwareentwicklung am Rechner und/oder Hardwareentwicklung, Anwendung leistungsfähigster Software, Beamer (Präsentation der Ergebnisse), Bericht (elektronisch und Papier).				
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ eine Fragestellung aus dem Bereich der Elektromagnetik und Nanophotonik im Bauelementdesign selbständig wissenschaftlich behandeln.</li> <li>▪ die eigenen Ergebnisse mit Ergebnissen aus der Literatur vergleichen und einordnen</li> <li>▪ einen wissenschaftlichen Bericht und einen Vortrag der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums selbständig erstellen und in wissenschaftlicher Form präsentieren.</li> <li>▪ Arbeiten in Gruppen/Projekten effizient managen.</li> </ul>				

<b>Modultitel</b>	<b>Optical Communication Systems T3</b>				
<b>Lehrveranstaltungen</b>	<b>Titel</b>	<b>Form</b>	<b>SWS</b>	<b>Credits</b>	<b>Studien-/ Prüfungsleistung</b>
		Master Thesis in Optical Communication Systems	Abschlussarbeit (Master Thesis)	20	30
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	30				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Sommer- oder Wintersemester, Themen jederzeit auf Anfrage				
<b>Dozent</b>	Bangert und Mitarbeiter				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Bangert				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagenkenntnisse der optischen Kommunikationssysteme</li> <li>▪ Nachweis der Zulassungsvoraussetzung zur Master Thesis gemäß ONTE-Prüfungsordnung.</li> </ul>				
<b>Arbeitsaufwand</b>	300 Stunden Präsenzzeit 600 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rechnergestützter Entwurf nanophotonischer Kommunikationssysteme</li> <li>▪ Messtechnische Charakterisierung nanophotonischer Komponenten</li> <li>▪ Modellierung nanophotonischer Komponenten</li> <li>▪ Modellierung nanostrukturierter elektronischer Komponenten</li> <li>▪ Modellierung von optischen Kommunikationssystemen mit nanophotonischen Komponenten aus dem Blickwinkel der Systemtechnik</li> <li>▪ Methodenentwicklung moderner optischer Messtechnik für nanophotonische Komponenten, Bauelemente und Systeme</li> <li>▪ Experimentelle Charakterisierung moderner nanophotonischer Bauelemente und Systeme</li> <li>▪ Themen der Hochgeschwindigkeitselektronik</li> </ul>				
<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fachliteratur gemäß Thema der Arbeit.</li> </ul>				
<b>Medienformen</b>	Hardwareentwicklung und/oder Softwareentwicklung am Rechner, Beamer (Präsentation der Ergebnisse), Bericht (elektronisch und Papier).				
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ eine Fragestellung aus dem Bereich der optischer Kommunikationssysteme und verwandter Themen selbständig wissenschaftlich behandeln.</li> <li>▪ praktisch, sicher und vorsichtig mit nanophotonischen Komponenten umgehen.</li> <li>▪ optische Netzwerke inkl. nanostrukturierter und nanophotonischer Komponenten simulieren und unterschiedliche Messsysteme und Verfahren zur Charakterisierung nanophotonischer Komponenten verwenden.</li> <li>▪ den Einfluss nanophotonischer Komponenten auf Systemebene einordnen und beurteilen.</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ die eigenen Ergebnisse mit Ergebnissen aus der Literatur vergleichen und einordnen</li><li>▪ einen wissenschaftlichen Bericht und einen Vortrag der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums selbständig erstellen und in wissenschaftlicher Form präsentieren.</li><li>▪ Arbeiten in Gruppen/Projekten effizient managen.</li></ul>
--	--

Modultitel	Digital Communications T4				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
		Master Thesis in Digital Communications	Abschlussarbeit (Master Thesis)	20	30
Credits für das Gesamtmodul	30				
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Sommer- oder Wintersemester, Themen jederzeit auf Anfrage				
Dozent	Dahlhaus und Mitarbeiter				
Verantwortliche(r)	Dahlhaus				
Teilnahmevoraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagenkenntnisse der digitalen Kommunikation</li> <li>▪ Nachweis der Zulassungsvoraussetzung zur Master Thesis gemäß ONTE-Prüfungsordnung.</li> </ul>				
Arbeitsaufwand	300 Stunden Präsenzzeit 600 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verfahren in der physikalischen Schicht und Medienzugriffsschicht des OSI-Modells drahtloser Kommunikationssysteme mit mikro- und nanoskaligen Komponenten</li> <li>▪ Themen der digitalen Kommunikation.</li> </ul>				
Literatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J.G. Proakis, <i>Digital Communications</i>, McGraw-Hill, 4. Aufl., ISBN 0-07-118183-0.</li> <li>▪ H. Vincent Poor, <i>An Introduction to Signal Detection and Estimation</i>, Springer-Verlag, 2nd ed., ISBN 0-387-94173-8 or ISBN 3-540-94173-8</li> <li>▪ A. Papoulis, S. U. Pillai, <i>Probability, Random Variables, and Stochastic Processes</i>, McGraw-Hill, 4. Aufl., ISBN 0071226613.</li> <li>▪ H.L. van Trees, <i>Detection, Estimation, and Modulation Theory</i>, vol. I, New York, NY: John Wiley&amp;Sons, 1968.</li> <li>▪ Fachliteratur gemäß Thema der Arbeit.</li> </ul>				
Medienformen	Softwareentwicklung am Rechner und/oder Hardwareentwicklung, Beamer (Präsentation der Ergebnisse), Bericht (elektronisch und Papier).				
Angestrebte Lernergebnisse	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ eine Fragestellung aus dem Bereich der physikalischen Schicht und Medienzugriffsschicht des OSI-Modells in drahtlosen Kommunikationssystemen mit mikro- und nanoskaligen Komponenten und verwandter Themen selbständig wissenschaftlich behandeln.</li> <li>▪ die eigenen Ergebnisse mit Ergebnissen aus der Literatur vergleichen und einordnen</li> <li>▪ einen wissenschaftlichen Bericht und einen Vortrag der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums selbständig erstellen und in wissenschaftlicher Form präsentieren.</li> <li>▪ Arbeiten in Gruppen/Projekten effizient managen.</li> </ul>				

<b>Modultitel</b>	<b>Functional Safety T5</b>				
<b>Lehrveranstaltungen</b>	<b>Titel</b>	<b>Form</b>	<b>SWS</b>	<b>Credits</b>	<b>Studien-/ Prüfungsleistung</b>
	Master Thesis in Functional Safety	Abschlussarbeit (Master Thesis)	20	30	Bericht und Vortrag
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	30				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Sommer- oder Wintersemester, Themen jederzeit auf Anfrage				
<b>Dozent</b>	Börcsök und Mitarbeiter				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Börcsök				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grundlagenkenntnisse der Rechnerarchitektur</li> <li>▪ Nachweis der Zulassungsvoraussetzung zur Master Thesis gemäß ONTE-Prüfungsordnung</li> </ul>				
<b>Arbeitsaufwand</b>	300 Stunden Präsenzzeit 600 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Themen der sicheren Rechnerarchitekturen und nanooptischer Systemen (optical communication on multi core chips etc.)</li> <li>▪ Selbstständige wissenschaftliche Behandlung einer Fragestellung aus dem Bereich der optoelektronischer bzw. nanooptischer Architekturen in System- bzw. Rechnerarchitekturen mit Problemstellungen der funktionalen Sicherheit.</li> <li>▪ Modellierung und Berechnung von Parameter der funktionalen Sicherheit bei nanooptischen Komponenten und/oder Systemen.</li> <li>▪ Die Studierenden behandeln Probleme mit großem Anwendungs-potenzial, zum Teil mit Industriebeteiligung</li> </ul>				
<b>Literatur</b>	Fachliteratur gemäß Thema der Arbeit.				
<b>Medienformen</b>	Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung am Rechner, Beamer (Präsentation der Ergebnisse), Bericht (elektronisch und Papier).				
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Theoretische Modelle für Probleme der Funktionalen Sicherheit beim Einsatz von nanooptischen bzw. optischen Komponenten für ein bestimmtes Problem herleiten.</li> <li>▪ Messdaten und statistische Ergebnisse aus Sicherheitsmodellen in wissenschaftlicher Form analysieren und bewerten.</li> <li>▪ Fragestellungen aus dem Bereich der funktionalen Sicherheit mit Einsatz von optischen bzw. nanooptischen Komponenten selbständig wissenschaftlich behandeln.</li> <li>▪ die eigenen Ergebnisse mit Ergebnissen aus der Literatur vergleichen und einordnen</li> <li>▪ einen wissenschaftlichen Bericht und einen Vortrag der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums selbständig erstellen und in wissenschaftlicher Form präsentieren.</li> <li>▪ Arbeiten in Gruppen/Projekten effizient managen.</li> </ul>				

## Qualifikationsmodule

Fehlen Bewerberinnen/Bewerbern Voraussetzungen für die Zulassung zum ONTE–Masterstudium, kann der Prüfungsausschuss gemäß §5 Abs.(5) der ONTE–Prüfungsordnung die Zulassung unter der Auflage aussprechen, dass bis zur Anmeldung der Masterarbeit die fehlenden Kenntnisse durch erfolgreiches Absolvieren von Modulen im Umfang von maximal 30 Credits aus den im Folgenden aufgelisteten Modulen nachgewiesen werden.

Die Module sind thematisch gegliedert in die Bereiche

- **Electromagnetics and Optics**
- **Mathematics**
- **Engineering Physics, Materials and Chemistry**
- **Fundamentals of Signal Processing and Communications**
- **Language Course Technical English**
- **Optical Communication Systems**
- **Safety and Computer Architectures.**

Innerhalb eines Bereichs gilt für die Module die o.g. Namenskonvention <BEREICH TYP NR> wie z.B. Electromagnetics and Optics *Q1*, wobei TYP gleich **Q** (für **Q**ualifikationsmodul) ist und NR wiederum eine laufende Nummer bezeichnet.

Modultitel	Electromagnetics and Optics Q1				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Electromagnetics (lec)	Vorlesung	2	3	2-stündige schriftliche Prüfung oder 30-minütige mündliche Prüfung
	Electromagnetics (ex)	Übung	1	1	
	Optics (lec)	Vorlesung	3	4	2-stündige schriftliche Prüfung oder 30-minütige mündliche Prüfung
	Optics (ex)	Übung	1	1	
Credits für das Gesamtmodul	9				
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Wintersemester oder im Sommersemester				
Dozent	Hillmer und Witzigmann				
Verantwortliche(r)	Witzigmann				
Teilnahmevoraussetzungen	Grundlagenkenntnisse der elektronischen Bauelemente (Dioden, Transistor), Grundlagenkenntnisse Materialwissenschaften				
Arbeitsaufwand	180 Stunden Präsenzzeit 60 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<u>Electromagnetics:</u> Electrostatics & Magnetostatics <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coulomb's Law, Gauss' Law, Polarization, Biot-Savart Law</li> <li>▪ Integral Theorems (Gauss, Stokes), Operators</li> <li>▪ Poisson, Laplace Equation</li> <li>▪ Transition conditions and boundary conditions</li> <li>▪ Fundamentals of Maxwells Equations</li> <li>▪ Differential and integral formulation</li> <li>▪ Vectorial Wave Equation, Helmholtz Equation</li> <li>▪ Plane Wave, TEM Wave</li> <li>▪ Poynting Vector</li> <li>▪ Time vs. Frequency Domain</li> </ul> <u>Basics of Optics:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Basics of different models: Ray optics Wave optics (Quantum optics)</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geometric optics: Geometrical propagation of light, Fermat principles, Mirror, Thin lens, Lens Aberrations, Chromatic aberration, Spherical aberration</li> <li>▪ Diffraction and polarization: Introduction to Diffraction, Diffraction from Narrow Slits, Resolution of Single-Slit and Circular Apertures, The Diffraction Prism and Grating, Diffraction of X-Rays by Crystals, Polarization of Light Waves</li> <li>▪ Interference: Conditions for Interference, Young's Double-Slit Experiment, Intensity Distribution of the Double-Slit Interference Pattern, Phasor Addition of Waves, Change of Phase Due to Reflection, Interference in Thin Films, Interferometer</li> <li>▪ Huygens principle for a/an: Light beam Interface between 2 different media Prism Single slit Grating with unextended slits Grating with extended slits Binary optics Phase gratings, step index gratings</li> <li>▪ Introduction to Maxwell' equations and wave equation: Light and Wave Motion Types of Waves in General, Properties of Waves, Wave Equations, Principle of Superposition, Interference, Reflection, Transmission, and Resonance; Wave nature of light: Boundary conditions, Coherence, Diffraction, Young's double slit experiment</li> <li>▪ Basic properties of light: Wave nature of light, Refraction index, Group velocity and group index, Laws of reflection and transmission, Particle nature of light and De Broglie hypothesis</li> <li>▪ Optical imaging: Formation of an image, Eye, Camera, Microscope, TEM, SEM</li> <li>▪ Einführung in die Fachtermini. Ausführliche Erklärung aller verwendeten Fachbegriffe</li> <li>▪ Einführung in die Optik</li> <li>▪ Veranschaulichung des Brechungsindex, der Polarisierung, der Interferenz, der Brechung und der Beugung</li> <li>▪ Detaillierte Verdeutlichung der Spalt- und Gitter-Beugung, wobei die Sensitivität bezüglich nanoskaliger Variationen besonders geschärft wird</li> <li>▪ Unterstützung letzteren Punkts durch In-situ Simulationstools, wobei das Bedienungs-Template und das Resultat mit dem Beamer projiziert werden</li> <li>▪ Materialeigenschaften von Glas: Dispersion, Absorption</li> <li>▪ Optische Wellenleiter</li> <li>▪ Interferometer</li> <li>▪ Einführung in die Grundlagen von Laser, LEDs, Photodioden und Solarzellen</li> </ul>
--	--

<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J.Gowar, <i>Optical Communication Systems</i>, 2<sup>nd</sup> Ed., Prentice Hall, 1993.</li> <li>▪ K.Iga, S.Kinoshita, <i>Process technology for semiconductor lasers</i>, Springer, Series in Material Science 30, 1996.</li> <li>▪ S.L.Chuang, <i>Physics of Optoelectronic Devices</i>, John Wiley &amp; Sons, New York, 1995.</li> <li>▪ F. Träger (Editor), <i>Springer Handbook of Lasers and Optics</i>, Springer, 2007.</li> </ul>
<b>Medienformen</b>	Verwendung von softwaretechnischen interaktiven Visualisierungstools, die die Studierenden im hands-on Betrieb erfahren, Beamer (Vorlesungspräsentation), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen).
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Grundlagen optischer und optoelektronischer Bauelemente wiedergeben.</li> <li>▪ den Aufbau und die Betriebsprinzipien grundlegender optoelektronischer Bauelemente nachvollziehen.</li> <li>▪ das Anwendungspotenzial optoelektronischer Bauelemente und photonischer Werkzeuge einschätzen.</li> <li>▪ grundlegende optoelektronische Probleme berechnen.</li> <li>▪ Die Zusammenspiele elektronischer, optischer und , thermischer Phänomene in optoelektronischen Bauelementen in stark vereinfachter Form wiedergeben</li> <li>▪ Grundkenntnisse des Betriebs und des Einsatzes optoelektronischer Bauelemente wiedergeben.</li> <li>▪ Grundlagen des händischen Zeichnens wissenschaftlicher Diagramme und Skizzen anwenden, so dass der Studierende wissenschaftlich diskutieren kann</li> </ul>

Modultitel	Mathematics Q2				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Mathematics 1 (lec)	Vorlesung	1	2	2-stündige schriftliche Prüfung
	Mathematics 1 (ex)	Übung	1	1	
	Mathematics 2 (lec)	Vorlesung	1	2	2-stündige schriftliche Prüfung
	Mathematics 2 (ex)	Übung	1	1	
Credits für das Gesamtmodul	6				
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Wintersemester oder im Sommersemester				
Dozent	Witzigmann und Bangert				
Verantwortliche(r)	Bangert				
Teilnahmevoraussetzungen	Grundlagenkenntnisse der Algebra, Differenzialrechnung, Integralrechnung				
Arbeitsaufwand	100 Stunden Präsenzzeit 80 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Linear Equations: Linear Equations, solutions of systems</li> <li>▪ Matrices: Introduction, basic properties Determinants, solutions of systems</li> <li>▪ Trigonometry: Trigonometric basics and identities, right angles triangles General triangle formulae</li> <li>▪ Functions: Introduction, motivation Types – Linear, polynomial, power, exponential, logarithmic</li> <li>▪ Limits: Introduction to Limits, properties Limit Rules, problem solving with various functions</li> <li>▪ Scalars and Vectors: Basics, properties, Coordinate systems Scalar and Vector Products</li> <li>▪ Differential Calculus: Definition of the Derivative</li> </ul>				

	<p>Derivative properties  Derivatives of Some Basic Functions  Second Order Derivative  Partial Derivative  Applications of Derivative: Maximum and Minimum and Taylor expansion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integral Calculus:  Meaning of Integration  Why Do We Need Integration?  Types of Integration  Integration Techniques: Substitution, Integration by Parts, Trigonometric Method, Trigonometric Substitution and Numerical Integration  Application of Integration: Area, volume and work</li> <li>▪ Differential Equations:  Definition of Differential Equation  Why Study Differential Equations?  Ordinary Differential Equation (ODE)  Partial Differential Equation (PDE)  Order and Degree of a Differential Equation  Differential Equation solving: Separable First Order Differential Equation, Homogeneous First Order Differential Equation, Linear First Order Differential Equation and Linear Homogeneous Second Order Differential Equation  Partial differential Equation (PDE)  Applications of Partial Differential Equation: Heat Equation and Numerical solutions to the Heat Equation</li> <li>▪ Fourier Series, Fourier and Laplace Transforms:  Fourier series  Fourier Transform  Laplace transform</li> </ul>
<b>Literatur</b>	wird in der Vorlesung bekanntgegeben
<b>Medienformen</b>	Beamer (Vorlesungspräsentation), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen)
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ grundlegende Konzepte der Mathematik nachvollziehen.</li> <li>▪ die Grundlagen der Vektor-/Tensoralgebra, Vektor-/Tensoranalysis, Differentialgleichungen, Fourier- und Laplace-Transformation anwenden.</li> <li>▪ Eigenwertprobleme verstehen und ansatzweise behandeln</li> <li>▪ den Eigenwertproblemaufbau bestimmter nanophotonischer Probleme nachvollziehen, wie sie in den Mastermodulen vorkommen in der Quantenmechanik und Wellengleichung,</li> <li>▪ Methodik der Behandlung von Festkörperkristallproblemen ansatzweise nachvollziehen</li> <li>▪ grundlegende geometrische Wellen-Probleme berechnen und zeichnen wie sie in den nachfolgenden regulären Mastermodulen gefordert sind.</li> </ul>

Modultitel	Engineering Physics, Materials and Chemistry Q3				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Physics (lec)	Vorlesung	1	2	2-stündige schriftliche Prüfung oder 30-minütige mündliche Prüfung
	Materials and Chemistry (lec)	Vorlesung	2	2	
	Semiconductor Physics (lec)	Vorlesung	3	4	2-stündige schriftliche Prüfung oder 30-minütige mündliche Prüfung
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	8				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Wintersemester und im Sommersemester				
<b>Dozent</b>	Hillmer				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Hillmer				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	Grundlagenkenntnisse der elektronischen Bauelemente (Dioden, Transistor) und der Physik				
<b>Arbeitsaufwand</b>	180 Stunden Präsenzzeit 60 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Measurement of physical properties and units in physics: Introduction of basic common symbols, Fundamental Units, Conversion of Units, Vectors</li> <li>▪ Continuum Mechanics: Stress, Strain, Poisson's Ratio, Surface Tension, Capillary Effect, Viscosity, Elastic Moduli: Young's Modulus, Shear Modulus, Bulk Modulus</li> <li>▪ Structure of matter: Structure of atoms, chemical bindings in molecules, chemical bindings in solids</li> <li>▪ Crystallography: Classification of Solids, Description of Crystal Lattice by Vectors: Unit Cell, Bravais Lattice, Miller Indices, Methods of Solid Structure Investigation: Bragg's Law and Diffraction, X-ray Diffraction</li> <li>▪ Dielectric materials: physical models of electrical polarization</li> <li>▪ Magnetic materials: macroscopic description of magnetic properties, atomistic description of magnetic properties</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chemical reactions: law of mass action basics of chemical etching of solids redox reactions</li> <li>▪ Quantum Physics: Limitations of Classical Physics: Black Body Radiation, Photoelectric Effect, Wave Particle Duality: De Broglie's Hypothesis, Schrödinger Equation</li> <li>▪ Statistical Physics: Boltzmann Distribution, Maxwell-Boltzmann Distribution, Fermi-Dirac Distribution, Bose-Einstein Distribution</li> <li>▪ Halbleiterphysik: Grundlagen, das Elektron und das Loch, die Bandlücke, Bindungsmodell, Eigenleitung, Fremdleitung, Diffusionsströme und Feldströme, Bändermodell im Orts- und k-Raum, Fermienergie, Boltzmannverteilung, Fermiverteilung</li> <li>▪ pn-Diode: pn-Übergang, Diffusionsspannung, Diodenkennlinie, Raumladungszone, thermisches Verhalten, Wärmewiderstand, Nichtidealitäten der realen pn-Diode, Rekombination in der Raumladungszone, pin-Diode, Schottky-Diode, Feldeffekt Bipolartransistor und Feldeffekttransistor: Aufbau und Funktionsprinzip</li> <li>▪ Einführung in die Fachtermini. Ausführliche Erklärung aller verwendeten Fachbegriffe</li> <li>▪ Einführung in das Periodensystem der Elemente</li> <li>▪ Physik der Festkörperkristalle</li> <li>▪ Amorphe Materialien und Gläser</li> <li>▪ Unterstützung der Kristalltechnologie durch In-situ Simulationstools, wobei das Bedienungs-Template und das Resultat mit dem Beamer projiziert wird</li> <li>▪ Materialeigenschaften von Metallen, Isolatoren und Halbleitern</li> <li>▪ Kovalente und ionische Kristallbindung</li> <li>▪ Stabilitätskriterien von Verbindungshalbleitern, Achterschalenkriterium</li> <li>▪ Methodik der Reaktion von chemischen Elementen zu stabilen Kristallen</li> <li>▪ Einführung in die Grundlagen von Schalen und Orbitalmodellen</li> <li>▪ Redoxreaktionen</li> <li>▪ Mechanische Oszillationen mit korrespondierenden Differentialgleichungen</li> </ul>
<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben</li> <li>▪ S.M.Sze "Semiconductor Physics"</li> </ul>
<b>Medienformen</b>	Beamer (Vorlesungspräsentation), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen), Experimente (Praktikum).
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Grundlagen der Halbleiterelektronik, insbesondere der Bändermodelle wiedergeben</li> <li>▪ Das Zustandekommen unterschiedlicher Bandlücken und Lagen der Fermienergie auf der Energieachse nachvollziehen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ das Anwendungspotenzial von Halbleitermaterialien und den Halbleiterbauelementen einschätzen.</li><li>▪ grundlegende halbleitertechnische Probleme berechnen, wie die Elektronenkonzentration im Leitungsband, die Löcherkonzentration im Valenzband, Feldströme, Diffusionsströme, der Feldverlauf und der Potentialverlauf (Bandkantenverlauf) in der Raumladungszone eines pn-Übergangs,</li><li>▪ die komplexen Zusammenspiele von thermischen Eigenschaften und elektronischen Ladungsträgerverteilungen wiedergeben</li><li>▪ die Grundlagen der Materialwissenschaften und der anorganischen Chemie wiedergeben.</li><li>▪ den Aufbau der Festkörperkristalle insbesondere der Halbleiterkristalle nachvollziehen.</li><li>▪ das Anwendungspotenzial von Festkörpermaterialien und Gläsern einschätzen.</li><li>▪ grundlegende kristallographische Probleme berechnen.</li><li>▪ die komplexen Zusammenspiele von thermischen Eigenschaften und Materialeigenschaften wiedergeben</li></ul>
--	--

Modultitel	Fundamentals of Signal Processing and Communications Q4				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien-/ Prüfungsleistung
	Fundamentals of Signal Processing and Communications (lec)	Vorlesung	2	4	2-stündige schriftliche Prüfung oder 30-minütige mündliche Prüfung
	Fundamentals of Signal Processing and Communications (ex)	Übung	1	1	
Credits für das Gesamtmodul	5				
Sprache	Englisch				
Durchführung	im Wintersemester und im Sommersemester				
Dozent	Dahlhaus				
Verantwortliche(r)	Dahlhaus				
Teilnahmevoraussetzungen	Grundlagenkenntnisse der Mathematik				
Arbeitsaufwand	90 Stunden Präsenzzeit 60 Stunden Selbststudium				
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Introduction: <ul style="list-style-type: none"> <li>Basics in signals and systems</li> <li>Fundamental signal processing schemes: detection and estimation</li> <li>Communications: waveform signaling and transmission</li> </ul> </li> <li>▪ Signals and Systems: <ul style="list-style-type: none"> <li>Description of signals and systems</li> <li>Linear channels: kernels and convolution</li> <li>Eigenfunctions of linear time-invariant channels and the Fourier transform</li> <li>Kirchhoff networks</li> <li>Signal spectra and filtering</li> <li>Sampling of deterministic signals: the Shannon-Kotelnikov theorem</li> </ul> </li> <li>▪ Basics in Statistical Signal Processing: <ul style="list-style-type: none"> <li>Deterministic vs. stochastic description of physical phenomena</li> <li>Probability and random variables</li> <li>Multivariate Gaussian density functions and properties</li> <li>Wide-sense stationary stochastic processes: spectra and correlation functions</li> <li>Examples of detection and estimation problems</li> </ul> </li> <li>▪ Basics in Communications: <ul style="list-style-type: none"> <li>Band-pass signals and systems: the complex baseband representation</li> <li>Analog vs. digital modulation</li> </ul> </li> </ul>				

	Binary transmission over the additive white Gaussian channel: optimum detection and bit-error rate performance
<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J.G. Proakis, <i>Digital Communications</i>, McGraw-Hill, 4<sup>th</sup> ed., ISBN 0-07-118183-0.</li> <li>▪ <a href="#">Athanasios Papoulis</a>, <a href="#">S. Unnikrishna Pillai</a>, <i>Probability, Random Variables, and Stochastic Processes</i>, Mcgraw-Hill Publ.Comp.; 4th ed., international edition, January 2002</li> </ul>
<b>Medienformen</b>	Beamer (Vorlesungspräsentation), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen).
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Signale und Systeme gemäß unterschiedlicher Kategorien klassifizieren und geeignet beschreiben</li> <li>▪ klassische Parameter linearer Systeme zum Systementwurf verwenden</li> <li>▪ eine Signal- und Systemcharakterisierung im Frequenzbereich durchführen</li> <li>▪ deterministische und stochastische Beschreibungen von Signalen und Systemen für unterschiedliche Anwendungen nachvollziehen und fundamentale resultierende Verfahren der Signalverarbeitung wie Signaldetektion und -schätzung verstehen</li> <li>▪ Signalübertragung in Systemen mit nanoskaligen Elementen beschreiben und Detektionsverfahren verstehen.</li> </ul>

Modultitel	Language Course Technical English Q5				
Lehrveranstaltungen	<b>Titel</b>	<b>Form</b>	<b>SWS</b>	<b>Credits</b>	<b>Studien- / Prüfungsleistung</b>
	Technical English (lec)	Vorlesung	1	1	Insgesamt 90 Minuten, schriftliche und mündliche Prüfung
	Technical English (ex)	Übung	1	1	
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	2				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Wintersemester und im Sommersemester				
<b>Dozent</b>	Universitätssprachenzentrum				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Börczök				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	Englische Grundlagenkenntnisse				
<b>Arbeitsaufwand</b>	30 Stunden Präsenzzeit 30 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Technical English</li> <li>▪ Especially focused are the fields of: Geometry, shape and materials, graphs, Electromagnetics Optics Mathematics Physics, Materials, Chemistry Signal Processing Optical Communication Systems Computer Architecture and Safety</li> <li>▪ Grammar</li> <li>▪ Discussion</li> <li>▪ Presentation</li> </ul>				
<b>Literatur</b>	wird in der Vorlesung bekanntgegeben				
<b>Medienformen</b>	Tafel, Sprachlabor, Papier (Übungen)				
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende ist in der Lage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die englischsprachigen Lehrveranstaltungen zu verstehen</li> <li>▪ sich an englischsprachigen Diskussionen zu beteiligen</li> <li>▪ wissenschaftliche Berichte in englischer Sprache zu erstellen</li> <li>▪ wissenschaftliche Präsentationen und Vorträge in englischer Sprache im Rahmen eines Kolloquiums zu halten</li> <li>▪ sich auf internationalem Boden mit Kollegen in englischer Sprache auszutauschen</li> </ul>				

Modultitel	Optical Communication Systems Q6				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien- / Prüfungsleistung
	Optical Communication Systems (lec)	Vorlesung	2	3	30-minütige mündliche Prüfung
	Optical Communication Systems (ex)	Übung	1	1	
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	4				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Wintersemester und im Sommersemester				
<b>Dozent</b>	Bangert				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Bangert				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	Grundlagenkenntnisse der elektronischen Bauelemente (Dioden, Transistor), Grundwissen der Optik				
<b>Arbeitsaufwand</b>	70 Stunden Präsenzzeit 50 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einführung in die Fachtermini. Ausführliche Erklärung aller verwendeten Systemfachbegriffe</li> <li>▪ Einführung in die optische Kommunikationstechnik</li> <li>▪ Einführung in die Displaytechnik</li> <li>▪ Wellenlängenmultiplexsysteme, Zeitmultiplexsysteme</li> <li>▪ Unterstützung der Inhalte durch In-situ Simulationstools, wobei das Bedienungs-Template und das Resultat mit dem Beamer projiziert werden</li> <li>▪ Optische Wellenleiter aus Systemsicht</li> </ul>				
<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J.Gowar, <i>Optical Communication Systems</i>, 2<sup>nd</sup> Ed., Prentice Hall, 1993</li> <li>▪ Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben</li> </ul>				
<b>Medienformen</b>	Verwendung von softwaretechnischen interaktiven Visualisierungstools, die die Studierenden im hands-on Betrieb erfahren, Beamer (Vorlesungspräsentation), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen).				
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kann die Grundlagen optischer Kommunikationssysteme wiedergeben.</li> <li>▪ kann den Aufbau und die Betriebsprinzipien grundlegender optoelektronischer Kommunikationssysteme nachvollziehen.</li> <li>▪ kann das Anwendungspotenzial optoelektronischer Kommunikationssysteme und photo-nischer Werkzeuge einschätzen.</li> <li>▪ kann grundlegende optoelektronische Systemprobleme berechnen.</li> <li>▪ hat Grundkenntnisse des Betriebs und des Einsatzes optoelektronischer Kommunikationssysteme erworben</li> </ul>				

Modultitel	Safety and Computer Architecture Q7				
Lehrveranstaltungen	Titel	Form	SWS	Credits	Studien- / Prüfungsleistung
	Reliabletheory of computer architectures (lec)	Vorlesung	2	2	2-stündige schriftliche Prüfung oder 30-minütige mündliche Prüfung
	Reliabletheory of computer architectures (ex)	Übung	1	2	
<b>Credits für das Gesamtmodul</b>	4				
<b>Sprache</b>	Englisch				
<b>Durchführung</b>	im Sommersemester, jährlich				
<b>Dozent</b>	Börcsök und Mitarbeiter				
<b>Verantwortliche(r)</b>	Börcsök				
<b>Teilnahmevoraussetzungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abgeschlossenes B.Sc.-Studium,</li> <li>▪ Programmierkenntnisse,</li> <li>▪ Grundlagen der Informatik,</li> <li>▪ Digitaltechnik,</li> <li>▪ Mikroprozessoren oder Rechnerarchitektur,</li> <li>▪ Regelungstechnik,</li> <li>▪ Mathematik</li> </ul>				
<b>Arbeitsaufwand</b>	60 Stunden Präsenzzeit 120 Stunden Selbststudium				
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wahrscheinlichkeits-, Verfügbarkeits- und Sicherheitsbetrachtung von Rechnersystemen,</li> <li>▪ mathematische Modellbeschreibungen unterschiedlicher Rechnersysteme.</li> <li>▪ Funktionsblockanalyse,</li> <li>▪ Markov-Modell,</li> <li>▪ Prüfverfahren,</li> <li>▪ Beispielanwendungen aus verschiedenen Applikationen.</li> </ul>				
<b>Literatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J. Börcsök, electronic safety systems, Huethig, 2ed 2007 ISBN 3-7785-2944-7</li> <li>▪ M. Rausand, et. al., Wiley 2nd ed, 2004, ISBN 0-471-47133-X</li> <li>▪ E. Hennly, et. al., Reliability Engineering and Risk assessment, IEEE Press 1991,</li> </ul>				
<b>Medienformen</b>	Beamer (Vorlesungspräsentation), Tafel (Herleitungen, Erläuterungen), Papier (Übungen), Experimente (Praktikum).				
<b>Angestrebte Lernergebnisse</b>	<p>Der/die Studierende kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ unterschiedliche Rechnerarchitekturen mathematisch modellieren.</li> <li>▪ gegebene Architekturmodelle analysieren und berechnen.</li> <li>▪ die komplexen Zusammenspiele elektronischer Systeme in sicherheitskritischem Umfeld erfassen und elektronische Sicherheitssysteme beurteilen.</li> </ul>				